

檔 號：

保存年限：

教育部 函

機關地址：100217 臺北市中正區中山南路
5號

承辦人：何幸霖

電話：(02)7736-5885

電子信箱：slhe@mail.moe.gov.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國112年3月7日

發文字號：臺教高通字第1122200587號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：113年度甄選簡章(附件一 A09000000E_1122200587_senddoc2_Attach1.pdf)

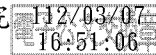
主旨：本部「113年度藝術與設計菁英海外培訓計畫」甄選簡章
(如附件)已於網站公告，請踴躍推薦學生或鼓勵學生
自行報名，請查照。

說明：

- 一、旨揭計畫甄選簡章公告於本計畫網站，請逕至以下網址
下載：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/2023MOE/>。
- 二、有關各組經學校推薦、個人申請，以及榮獲「新一代設
計展金點新秀設計獎年度最佳設計獎」者，報名日期為
即日起至112年5月31日(星期三)止；報名方式及其他
須知均於簡章中明定，報名前請詳閱簡章內容。

正本：各公私立大學校院(國立空中大學、高雄市立空中大學除外)

副本：文化部、經濟部工業局、財團法人台灣設計研究院



國立中興大學



1120004117 112/03/07

113 年度

教育部『藝術與設計菁英海外培訓計畫』

數位動畫組、視覺傳達設計組、產品設計組、
建築與景觀設計組、時尚設計組

甄選簡章

主辦單位：教育部

官方網站：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/2023MOE/>

承辦單位：國立雲林科技大學—數位動畫組、視覺傳達設計組、時尚設計組

地址：雲林縣斗六市大學路 3 段 123 號

計畫總辦公室(設計三館 DA401)

電話：(05)534-2601 轉 6593

國立成功大學工業設計系—產品設計組

地址：臺南市大學路 1 號

光復校區工業設計系系辦

電話：(06)275-7575 轉 54343

國立成功大學建築學系—建築與景觀設計組

地址：臺南市大學路 1 號

成大創意基地(C-Hub)5F

電話：(06)275-7575 轉 50239

協辦單位：台南應用科技大學—時尚設計組(研習營)

地址：臺南市永康區中正路 529 號

服飾設計管理系系辦

目錄

章節	項目	頁數
	計畫簡章	1
	數位動畫組	8
	視覺傳達設計組	15
	產品設計組	22
	建築與景觀設計組	29
	時尚設計組	36
附錄一	2023 年語文檢定考試參考資料	42
附錄二	教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表	49
附錄三	國立雲林科技大學位置圖	53
附錄四	台南應用科技大學位置圖	54
附錄五	國立成功大學位置圖	55
附表一	數位動畫組報名表	56
附表二	視覺傳達設計組報名表	58
附表三	產品設計組報名表	60
附表四	建築與景觀設計組報名表	62
附表五	時尚設計組報名表	64
附表六	老師推薦函	66

113 年度教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」徵選簡章

壹、培訓期限：自 113 學年度起至 114 學年度止，共計國外進修培訓一年。

貳、申請資格：

111 學年度各公私立大學校院大學部二年級以上或研究所碩士班在學學生(含進修學士班，但不含在職專班)，具有中華民國國籍，設有戶籍者，且從未獲本計畫選送出國之學生。出國進修前，須具備國內學校在學學生身分，國外進修培訓期間，亦需具備國內學校在學學生身分，包含保有學籍者。

參、申請對象：

一、報名管道：分成**學校推薦**、**個人申請**、**獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者**三種。

二、**學校推薦**：由學校推薦學業成績優異且具有出國學習潛力之學生報名申請。應於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及下列資料：(1)大學(含)以上在學成績單、(2)作品集、(3)語言能力證明影本(可以大一英文課程成績證明)、(4)其他有助於審查之證明文件與資料影本等規定之相關文件、(4)學校系所推薦公文及(5)老師推薦函(附表)，每系所每組以 10 名為限。

個人申請：個人申請由學生自行報名申請。應於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及下列資料：(1)大學(含)以上在學成績單、(2)作品集、(3)語言能力證明影本(可以大一英文課程成績證明)及(4)其他有助於審查之證明文件與資料影本等規定之相關文件。

獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：依據 112 年 5 月新一代設計展官方公告之得獎名單，由獲獎學生自行報名申請，應於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及下列資料：(1)作品集、(2)語言能力證明影本(可以大一英文課程成績證明)、(3)其他有助於審查之證明文件與資料影本。

肆、報名日期及方式：

一、報名日期：**即日起至 112 年 5 月 31 日(星期三)**(系統自動截止關閉，逾期恕不受理。)

二、報名方式：**請依申請身分於 112 年 5 月 31 日(星期三)前**，於計畫網站之線上報名系統完成報名。

伍、報名特別注意事項：

一、報名資格之認定以考生上傳之報名資料為準，不另做驗證；但複審或決審錄取報到時，再依報名時所填之報名資格繳驗相關學生證等證件正本。

二、報名前應詳閱簡章，確認自身是否具有報名資格，並僅能於「**數位動畫組**」、「**視覺傳達設計組**」、「**產品設計組**」、「**建築與景觀設計組**」及「**時尚設計組**」擇一組報名。報名後，不得因任何理由更改報名組別。若因所繳交之各項證件不符，或有偽造、假借、塗改、矇混等情事，即認定不具備報名資格。

三、錄取報到後，須依規定日期前簽訂教育部「**藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書**」始得辦理出國進修，**報名時請慎重考慮自身相關因素及規定，錄取後不得以任何理由申請資格保留。**

四、本計畫獎學金之受獎學生於海外培訓機構所修得之學分，由受獎學生原就讀學校自行決定是否採計抵免原就讀學校學分。

五、為維持試務公平，本計畫複審錄取學員，**不得私下自行聯繫或另行申請同組所列任一海外培訓機構，如經查獲將取消資格。**



陸、初審第一階段國內研習營入選通知及第二階段國內研習營成績：

- 一、初審第一階段「國內研習營申請」預計錄取參加研習營人數：
 - (1) 學校推薦、個人申請：除時尚設計組依審查結果擇優錄取 20 名，備取 6 名外，其餘每組依審查結果擇優錄取 30 名，備取 10 名。
 - (2) 獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：每組至多錄取 3 名。
- 二、初審第一階段結果(研習營錄取通知)將於 112 年 6 月 12 日(星期一)前(依實際公告日為主)以 E-mail 寄發，同時公告於計畫網站。
- 三、初審第二階段「國內研習營」邀請國內外講師授課評分，並設有研習營規定，違反規定者扣分，併入計算總分。研習營期間另擇日安排面試。
- 四、初審第二階段「國內研習營」排序將於研習營後三個工作天內以 E-mail 寄發，同時公告於計畫網站。



柒、國內複審繳件與合格名單：

- 一、繳交海外培訓機構要求之外文語言門檻成績影本、「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列之國際競賽得獎證明影本(國際競賽一覽表依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，無則免繳)及申請志願表。國際競賽得獎證明佔計分比例 10%，外文語言成績僅為國內複審名單審查門檻，不另計分。**繳件期限詳見各組注意事項，以寄出時間為憑，逾期或未繳件概不受理，視同放棄。**
- 二、國內複審成績計算方式：初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+面試(10%)+「國際競賽得獎證明」成績(10%)之比例合計總分。依據總分作為海外培訓機構志願依序分發之排序。
- 三、複審合格名單經複審會議決議後，於計畫網站公告、E-mail 通知，合格者得依照規定期限，另行繳交海外決選申請資料。
- 四、複審名單決選方式及**語文能力審查原則**：(一)先按學員總成績名次及所繳之志願表排序，以海外培訓機構錄取名額最多 4 倍；每位學員最多送審 2 所培訓機構為原則分發語言成績合格者。(二)首輪分發後，如有餘額得由複審委員評定，依總成績名次序遞補語言成績未達標準者，且以接近申請標準者優先，最多補至額滿。若總成績同分則依序以(1)「國內研習營成績」、(2)「初審成績」比較，擇優送審之。(三)所有海外培訓機構申請表件由各組承辦學校統一收齊、集中申請，等候海外培訓機構決選通知。(四)**各組另有頒布審查原則者，詳見各組注意事項。**



捌、決選繳件及核定方式：

- 一、複審合格名單公布後，合格者需繳交海外培訓機構所規定之英文作品集、研習計畫、相關英譯表件資料及海外培訓機構要求之語文能力證明等。繳交日期則由各組承辦學校依海外學校期程另行公告。逾期繳件概不受理。
- 二、海外培訓機構之申請由各組承辦學校集中申請代辦，待海外培訓機構決選後由承辦學校直接公布獎學金得主。
- 三、實際錄取名單依據海外培訓機構決選結果而定，最多不得超過教育部獎學金核定名額；未通過海外培訓機構決選時，雖有名額亦不予錄取。

四、各海外培訓機構除依核定名額錄取正取生外得列備取生，依海外培訓機構之決選結果為依據，並以名次排序，如有缺額則以名次依序遞補。

五、實際錄取名單依據海外培訓機構決選結果及承辦學校公告之名單為準。

玖、決選放榜及錄取公告：

一、預訂於 113 年 6 月 14 日（星期五）前（確實時間以海外培訓機構公布決選結果彈性調整）於計畫網站公告錄取名單，並以 E-mail 寄發正、備取通知。

二、計畫網站：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/2023MOE/>

三、恕不受理電話查榜。

拾、報到及相關契約：

一、正取生：

1. 報到日期：113 年 6 月 21 日（星期五）前或接獲錄取通知後一週內完成辦理報到。
2. 報到時間、方式另書於錄取通知及報到注意事項，並於網站公告。
3. 報到時應繳(驗)證件：正取通知與報到單、身分證正反面影本、在學學生證明文件。
4. 未依規定日期辦理報到、未繳驗證件者或未完成簽約手續者，視為自願放棄，事後不得以任何理由要求補報到或補驗。
5. 正取生因自願放棄或未依規定完成報到、簽約手續，其缺額由同組辦理備取登記之備取生依名次高低依序遞補。
6. 學生於出國培訓前及培訓期間，需保有在學學生身分，倘失去在學學生身分即喪失培訓資格。

二、備取生：

1. 備取缺額公告日期：113 年 6 月 26 日（星期三）前。
2. 報到日期：113 年 6 月 28 日（星期五）前或接獲錄取通知後一週內完成備取登記及辦理報到。
3. 報到時間、方式另書於備取通知及報到注意事項，並於網站公告。
4. 報到時應繳(驗)證件：備取通知與報到單、身分證正反面影本、在學學生證明文件。
5. 未依規定日期辦理報到、未繳驗證件者或未完成簽約手續者，視為自願放棄，事後不得以任何理由要求補報到或補驗。

三、凡經本甄選公告錄取者須配合承辦學校簽訂教育部「藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書」，逾期未完成視為放棄。並依契約書內容及相關規定完成相關手續出國進修，逾期視為放棄，並取消錄取資格。簽約相關作業於錄取後另行通知。

四、凡經本甄選錄取，完成簽訂「藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書」者，其因進修所涉及之權利義務，悉依行政契約書及「教育部補助藝術與設計菁英國際進修實施要點」規定辦理(以上契約書及相關規定，嗣後若經修正，除另有規定外，按新修正規定辦理)。

拾壹、補助費用標準：

一、對學生之獎助項目參照教育部公費留學標準，除學雜費及實習費外，原得申請項目費用如出國手續費、往返機票費、月支生活費、綜合補助費及健康保險費等併入年支生活費中，以簡化支領項目(如下表)。本計畫之受獎學生若因獲頒海外培訓機構之獎學金，將扣除海外培訓機構之獎學金後，給予實際支付之學費總額。

二、培訓機構進修及公司實習如非於同一城市，將各依該地區補助生活費且亦不額外補助交通費。生活費依實際進修月份支領，以一年為限。

三、下表生活費基準嗣後如有調整，請依教育部最新公告為主。

1. 學費：檢據核實發給。		
2. 生活費：(單位：美元)		
地區/國家	城市或地區	年支生活費
美國	華盛頓特區(Washington, D.C.)、紐約市(New York City)、舊金山市(San Francisco)、波士頓市(Boston)、劍橋市(Cambridge)	20,000
	芝加哥市(Chicago)、洛杉磯市(Los Angeles)、聖地牙哥市(San Diego)、聖荷西市(San Jose)、聖塔克魯茲市(Santa Cruz)、聖塔芭芭拉市(Santa Barbara)	19,000
	史丹佛市(Stanford)、柏克萊市(Berkeley)、休士頓市(Houston)、西雅圖市(Seattle)、奧克蘭市(Oakland)、爾灣市(Irvine)、河濱市(Riverside)、巴沙迪納市(Pasadena)	18,000
	其他城市	17,000
日本	東京都(Tokyo)、大阪府(Osaka)、京都府(Kyoto)	20,000
	橫濱市(Yokohama)、名古屋市(Nagoya)、神戶市(Kobe)	18,000
	其他城市	17,000
印度	孟買市(Mumbai)	20,000
	新德里市(New Delhi)	19,000
	其他城市	16,000
亞洲	馬尼拉市(Manila)、斯里百家灣市(Bandar Seri Begawan)、雅加達市(Jakarta)	17,000
	曼谷市(Bangkok)、吉隆坡市(Kuala Lumpur)、金邊市(Phnom Pwnh)	16,000
	新加坡	18,000
	菲律賓、汶萊、泰國、馬來西亞、印尼、緬甸、柬埔寨、寮國、越南	15,000
俄羅斯	莫斯科市(Moscow)	20,000
	聖彼得堡市(St. Petersburg)	19,000
	其他城市	16,000
歐洲	倫敦市(London)、巴黎市(Paris)、奧斯陸市(Oslo)、日內瓦市(Geneva)、蘇黎世市(Zurich)、羅馬市(Rome)、威尼斯市(Venice)、阿姆斯特丹市(Amsterdam)、布魯塞爾市(Brussels)、伯明翰市(Birmingham)、愛丁堡市(Edinburgh)、里丁市(Reading)	20,000
	挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、德國、瑞士、盧森堡、奧地利、法國、義大利、西班牙、英國	19,000
	冰島、荷蘭、比利時、葡萄牙、愛爾蘭	18,000
	其他歐洲國家	15,000
加拿大		19,000
澳大利亞	雪梨市(Sydney)	19,000
	墨爾本市(Melbourne)、布里斯本市(Brisbane)	18,000
	其他城市	16,000
紐西蘭	奧克蘭市(Auckland)、基督城市(Christchurch)、皇后鎮市(Queenstown)、威靈頓市(Wellington)	16,000



	其他城市	15,000									
上述以外之其他國家及城市		12,000									
<p>註：</p> <p>1. 本標準奉行政院 104 年 10 月 14 日院授主預教字第 1040102187 號函、行政院主計總處 105 年 2 月 5 日主預教字第 1050100321 號及 106 年 3 月 22 日主預教字第 1060100558 號函示修正，嗣後如有調整，則依新調整之公費標準支給。</p> <p>2. 本部身心障礙公費留學生公費項目及支給數額標準之適用對象為依本部公費留學考試身心障礙考生注意事項報考且錄取者。</p> <p>3. 身心障礙公費留學生年支生活費增給，係基於學習輔具及其他協助學習需求之考量，其年支生活費，係以公費標準表年支生活費為母數：</p> <table border="1"> <tr> <td>類別一</td> <td>增給 20%</td> <td>重度以上之視、聽障或重度多重障礙者</td> </tr> <tr> <td>類別二</td> <td>增給 5%</td> <td>中度視、聽障、中度多重障礙或類別一以外其他障別重度以上者</td> </tr> <tr> <td>類別三</td> <td>增給 2%</td> <td>除以上二類外之其他身心障礙者</td> </tr> </table> <p>4. 身心障礙公費留學生之生活費支給認定係以報名時繳交身心障礙手冊（證明）所載永久性障礙為準。</p> <p>5. 本表將於公費標準表修正時，同步修正。</p> <p>6. 本公費撥款作業，悉依教育部會計作業程序規定辦理。</p>			類別一	增給 20%	重度以上之視、聽障或重度多重障礙者	類別二	增給 5%	中度視、聽障、中度多重障礙或類別一以外其他障別重度以上者	類別三	增給 2%	除以上二類外之其他身心障礙者
類別一	增給 20%	重度以上之視、聽障或重度多重障礙者									
類別二	增給 5%	中度視、聽障、中度多重障礙或類別一以外其他障別重度以上者									
類別三	增給 2%	除以上二類外之其他身心障礙者									

拾貳、錄取後注意事項：

- 一、錄取學員不得以任何理由申請保留錄取資格，另如發現報名資格不符規定，或所繳證件及資料有假借、冒用、偽造、變造等情事，取消其錄取資格。
- 二、錄取學員應自行注意其他補助計畫規定，如因計畫規則衝突而失資格應自負責任。
- 三、錄取學員於海外培訓期間，每月應定期撰寫一篇 500 字以上學習概況(包含圖片)，由承辦學校分享至本計畫網站及粉絲頁(臉書搜尋：藝術與設計菁英海外培訓計畫)。
- 四、錄取學員於一年培訓期滿回國後，需履行下列**推廣義務**：
 - (一) 成果發表會預演(由承辦學校指定地點)
 - (二) 教育部部內成果發表會
 - (三) 教育部記者會暨成果展
 1. 配合本活動準備工作，於指定時間(返國前)繳交各項個人文宣，例如：社群網站用推廣影片、展版設計圖文、展示作品模型或實體等。
 2. 依承辦學校規劃，於記者會後成果展期間進行成果導覽及主題座談會。
 3. 前項工作及圖文授權載於教育部與學員簽訂之「藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書」，遇有未盡事宜，若屬同類工作範疇，應配合承辦學校辦理。
 - (四) 另需於成果發表會後**三年內完成三項計畫推廣活動**，下列第一至第三項應擇二完成，第四項為必要履行項目：
 1. 製作一小時以上的學習心得線上教材(須經審查合格並有合法版權)。
 2. 參加暑期研習營一週(五個工作天)，擔任翻譯與心得分享工作。
 3. 擔任承辦學校規劃之設計工作坊講師一次。
 4. 出具國內或國外藝術與設計實務工作相關證明，依類別可區分為國內反饋實踐及國際產業鏈結。本項採累計點數制，所提證明經審核通過獲得下表頒布之點數，完成門檻為 5 點。本義務需完成至少兩項目，同項目可重複累計。

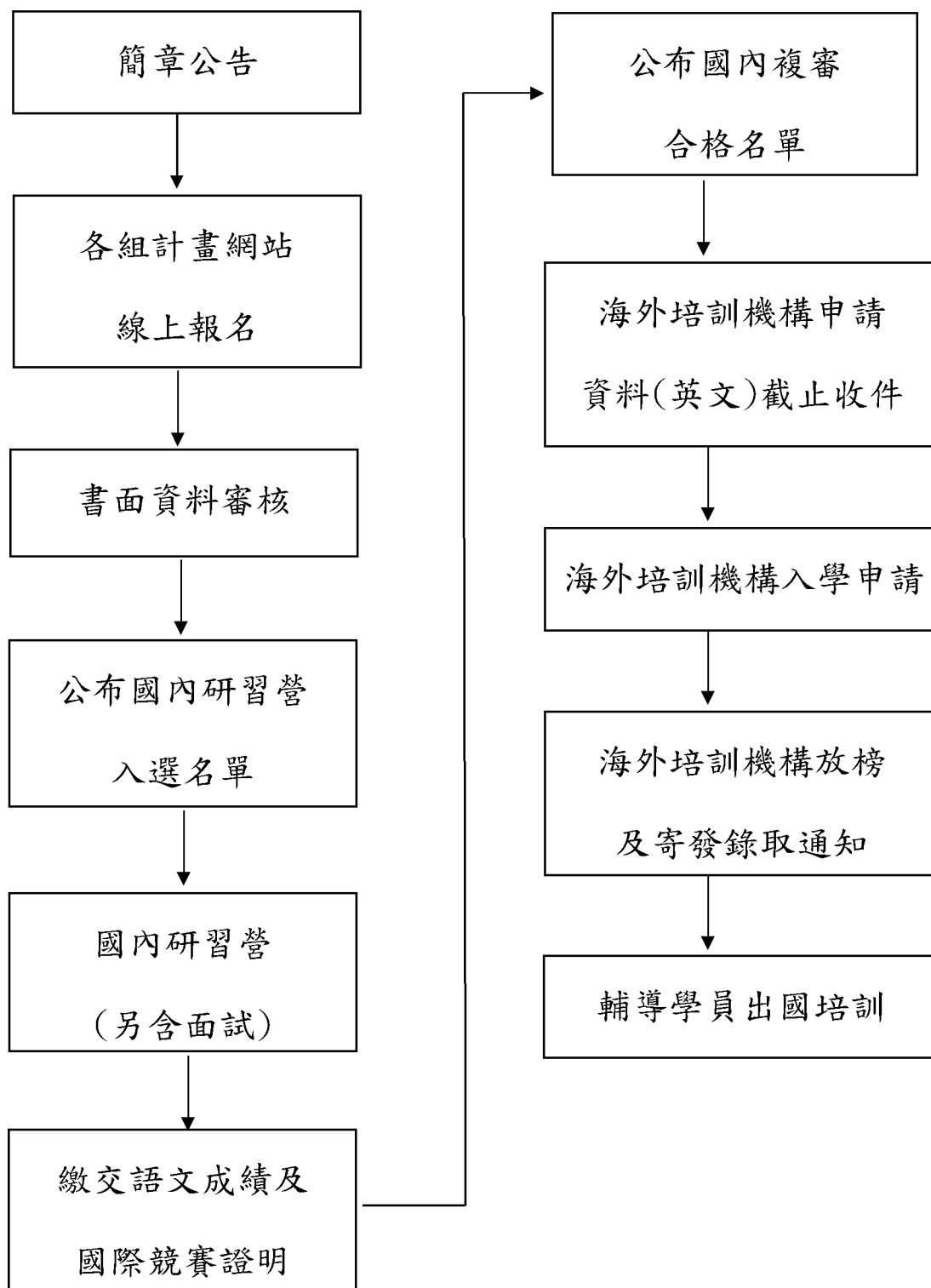


類別	項目	點數
國內實踐	任職產業1年以上，需提交在職證明(載明在任期間)及任職期間參與專案證明。	3
	以個人名義參與專案3件，需提交合約書與成果證明。	1
	擔任教育性質講師達12小時(不包含承辦學校規劃活動)，需提交授課單位開立之證明。	2
國際鏈結	引介國內外高等教育機構交流互訪，例如簽立合作備忘錄、國際工作營、國際研討會、學者演講等，需提交相關書信及訪問紀錄。	2
	促成國內外公司或機構合作案建立與進行，需提交相關書信及成案紀錄。	2
	參與國際設計相關組織職務或國際設計競賽評審工作，需提交相關聘書或證明。	1

五、若有其他情形或未盡事宜，悉依各組別甄選委員會決議辦理。



拾參、甄選流程圖：



數位動畫組

項目	頁數
一、培訓機構一覽表	9
二、甄選重要日程表	11
三、報名手續、應繳交證明文件及書面審查資料	12
四、徵選方式等相關規定	14



一、『數位動畫組』培訓機構一覽表

機構	錄取名額	初審		國內複審	海外培訓機構決選
		第一階段 國內研習營申請	第二階段 國內研習營		
美國 University of Southern California	1	資料審查 (佔總成績 20%) *參考備註 1	研習營成績 (佔總成績 60%) 面試成績 (佔總成績 10%) *參考備註 3	國際競賽得獎證明 (佔總成績 10%) 海外各機構要求之 語言成績證明 (不另計分) *參考備註 4	國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 90；或 IELTS 6.5 以上語言成績
美國 Savannah College of Arts and Design	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 85(各項不得低於 20)；或 IELTS 6.5(各項不得低於 6.5)以上語言成績
加拿大 Sheridan College	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 88(各項不得低於 21)；或 IELTS 6.5(各項不得低於 6.0)以上語言成績
英國 Teesside University					國外培訓機構規定資料與 IELTS 6.0 以上語言成績
法國 RUBIKA Valenciennes	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 45 以上證明；或 IELTS 4.0；或 TCF 法語檢定初級以上語言成績
法國 Gobelins, l'École de l'image	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 45；或 IELTS 4.0；或 TCF 法語檢定初級以上語言成績
荷蘭 AKV St. Joost	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 80；或 IELTS 6.0 以上語言成績
澳洲 RMIT University	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 79(各項最低標準：讀 13、聽 12、說 18、寫 21)；或 IELTS 6.5(各項不得低於 6.0)以上語言成績

備註

- 1、國內初審分兩階段，第一階段「國內研習營申請」繳交文件與審查之各項計分比例為：
 - (1)學校推薦、個人申請：作品集 50%、語言能力證明 20%、其他有助審查之證明文件與資料 30%。
 - (2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：作品集、語言能力證明、其他有助審查之證明文件與資料。
- 2、初審第二階段研習營之錄取名單依第一階段「國內研習營申請」審查成績辦理：
 - (1)學校推薦、個人申請：錄取 30 名，備取 10 名。
 - (2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：至多錄取 3 名。
- 3、國內研習營除外師之術科評分外，並設有研習營規定，違反規定者扣分，併入計算總分。另於研習營期間擇日安排面試。
- 4、國內複審：繳交各培訓機構要求門檻之語言成績證明、「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」所列各項國際競賽得獎證明影本（請參考附錄二，無則免繳。本組僅採計「綜合設計類」及「數位動畫類」獎項）及志願表。國際競賽得獎證明佔計分比例 10%，另語言成績為審查門檻不另計分。繳件期限為 **113 年 1 月 3 日(星期三)前**，以寄出時間為憑，逾期或未繳件概不受理，視同放棄。
- 5、語言成績除海外培訓機構在複審會議日期前公告受理 TOEFL My Best Scores 外，則一律不採用。
- 6、國內複審成績：以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「國際競賽得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據；並參考學員志願表挑選各培訓機構錄取名額最多 4 倍之合格名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。
- 7、美國 Savannah、加拿大 Sheridan、英國 Teesside、法國 RUBIKA、法國 Gobelins 之培訓機構，須於初、複審中經審定 3D 技能合格者才予以分發。
- 8、複審合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料及海外培訓機構要求之語文能力證明參加決選。繳交日期依海外培訓機構期程另行公告調整之。
- 9、申請非英語系國家，雖無硬性規定須交當地國語言成績，仍需具當地國基礎語言才能妥善學習。
- 10、前往英國 Teesside 進修者，申請英國學生簽證時需提出於 SELT(Secure English Language Testing)機構進行之英文考試成績如 IELTS UKVI。
- 11、當外交部公告海外培訓機構所處地區為旅遊紅色警戒區時，教育部得不選送學員至該機構進修，雖有缺額亦不錄取。

二、『數位動畫組』甄選重要日程表

作業事項	日期	說明
簡章公告	112年3月	
報名日期	即日起至112年5月31日(星期三)止	於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及指定資料，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。
繳交報名表件資料	即日起至112年5月31日(星期三)止	於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及指定資料，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。
公布初審第一階段合格名單與研習營錄取通知	112年6月12日(星期一)(依實際公告日為主)。	以E-mail通知第一階段「國內研習營申請」審查結果與研習營相關通知。
研習營正取生報到	於112年6月19日(星期一)前	將培訓同意書傳真或E-mail回報。
研習營備取生遞補	於112年6月21日(星期三)前	將培訓同意書傳真或E-mail回報。
國內研習營	1. 時間：112年7月3日(星期一)至7月14日(星期五)。 2. 地點：國立雲林科技大學。 3. 預計112年6月23日(星期五)前	公告課表於計畫網站，並由承辦學校協助研習學員報到與住宿安排。
公布研習營排	112年7月19日(星期三)	以E-mail寄發，並公告於計畫網站。
複審資料繳件日期	113年1月3日(星期三)前	※倘海外培訓機構更新新程，承辦學校將另行公告調整。
海外培訓機構申請資料繳交日期		於複審會議結果公告後，另行公告海外培訓機構申請截止日期。
海外培訓機構審核	113年1月至5月	
放榜及寄發備取通知	預計113年6月14日(星期五)前	放榜，確實時間以海外培訓機構公布決選結果彈性調整。
正取生報到	113年6月21日(星期五)前	
備取缺額公告	113年6月26日(星期三)前	
備取生報到	113年6月28日(星期五)前	

注意事項：

1. 本次甄選各項通知學生事項，均採E-mail通知及網站公告(網址：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/2023MOE/>)，必要時輔以掛號郵件郵寄。
2. 報名學生請注意「甄選重要日程表」各項作業時間；若於排定日程未接獲通知(E-mail)，請自行上網查詢或電話洽詢國立雲林科技大學—教育部菁培計畫總辦公室承辦人(05)534-2601分機6593。

三、報名手續、應繳交證明文件及書面審查資料

項	目	說	明
填寫報名表		請用正楷填寫報名表並確認無誤後，於簽名欄處由學生親自簽名。	
繳交相片		本人最近三個月內，二吋半身脫帽正面照片一張（黏貼於報名表）。	
繳交身分證影本 與學生證影本		1. 身分證正反面影本，字跡應清晰可辨（浮貼於報名表）。 2. 學生證正反面影本，字跡應清晰可辨（應蓋妥 111 學年度第二學期註冊章，浮貼於報名表）。	
國內初審第一階段應繳資料		<p>(一) 報名：一律採線上報名。請填寫本簡章報名表(附表一)，並於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及下列資料。各項資料送出前請確認完整無誤。</p> <p>(二) 初審第一階段：</p> <p>1. 學校推薦：</p> <p>(1) 大學(含)以上在學成績單，紙本成績單請以掃描方式提供，勿提供翻拍照片。</p> <p>(2) 作品集(足以證明其創作潛力的數位動畫相關作品)。規格可就下列兩項擇一繳交；作品集內若有團體作品，請註明個人於該作品之貢獻及組員人數、姓名。</p> <p>i) HD720 大小 Quick Time 檔案(以 10 分鐘為限)，及作品說明書。</p> <p>ii) 以動態腳本(animatic)闡述創作理念之半完成作品，媒體格式同前，及作品說明書。</p> <p>(3) 學校推薦公文。</p> <p>(4) 老師推薦函 (附表六)。</p> <p>(5) 語言能力證明影本 (GEPT、TOEIC、TOEFL、IELTS、Cambridge ESOL、日檢、法檢等)，若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單。</p> <p>(6) 其他有助於審查之證明文件與資料影本，將各類檔案彙整成一份檔案上傳。例如：特殊專長等證明、曾發表之作品、證照、獲獎紀錄等。</p> <p>2. 個人申請：</p> <p>(1) 大學(含)以上在校成績單。</p> <p>(2) 作品集(規範同學校推薦)。</p> <p>(3) 語言能力證明影本 (規範同學校推薦)。</p> <p>(4) 其他有助於審查之證明文件與資料影本(規範同學校推薦)。</p> <p>3. 獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：</p> <p>(1) 作品集(規範同學校推薦)。</p> <p>(2) 語言能力證明影本(規範同學校推薦)。</p> <p>(3) 其他有助於審查之證明文件與資料影本(規範同學校推薦)。</p> <p>(三) 初審資料繳交期限： 至112年5月31日(星期三)止，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。</p> <p>註1：上述各項證明文件得繳交影本，惟若因所繳交之各項證件不符，或有偽造、假借、塗改等情事，即認定不具備報名資格。</p> <p>註2：報名所繳之表件及審查資料，由計畫辦公室留存備查。</p>	

<p>國內複審應繳資料</p>	<p>(一) 書面資料審查：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 欲申請之海外培訓機構規定之語言成績證明(請參考當年度海外各培訓機構網站之最新公告標準)。繳件截止日期為113年1月3日(星期三)前，不接受補件，未繳交者，視同放棄(請參照附錄一2023年語文檢定考試時程資料，並及早應考)。 2. 「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」國際競賽得獎證明(國際競賽一覽表依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「數位動畫類」獎項)。 <p>(二) 志願表：申請本組學校標示研究所者，應於複審資料收件截止日前另提交國內研究所錄取證明。</p>																
<p>海外培訓機構決選應繳資料</p>	<p>國內複審合格者須檢送英文作品集、英文研習計畫及相關英譯表件資料等，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本。由本組承辦學校郵寄海外培訓機構進行決選，繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，承辦學校於國內複審結果公告後另行公告。</p> <table border="1" data-bbox="349 728 1437 1568"> <tr> <td data-bbox="349 728 646 828"> <p>美國 University of Southern California</p> </td> <td data-bbox="646 728 1437 828"> <p>TOEFL(iBT)90 或 IELTS 6.5 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="349 828 646 929"> <p>美國 Savannah College of Arts and Design</p> </td> <td data-bbox="646 828 1437 929"> <p>TOEFL(iBT)85 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於20；IELTS：各項不得低於6.5)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="349 929 646 1030"> <p>加拿大 Sheridan College</p> </td> <td data-bbox="646 929 1437 1030"> <p>TOEFL(iBT)88 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於21；IELTS：各項不得低於6.0)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="349 1030 646 1142"> <p>英國 Teesside University</p> </td> <td data-bbox="646 1030 1437 1142"> <p>IELTS 6.0 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="349 1142 646 1243"> <p>法國 RUBIKA Valenciennes</p> </td> <td data-bbox="646 1142 1437 1243"> <p>TOEFL(iBT)45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="349 1243 646 1355"> <p>法國 Gobelins, l'École de l'image</p> </td> <td data-bbox="646 1243 1437 1355"> <p>TOEFL(iBT)45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="349 1355 646 1456"> <p>荷蘭 AKV St. Joost</p> </td> <td data-bbox="646 1355 1437 1456"> <p>TOEFL(iBT)80 或 IELTS 6.0 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="349 1456 646 1568"> <p>澳洲 RMIT University</p> </td> <td data-bbox="646 1456 1437 1568"> <p>TOEFL(iBT)79 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL 各項最低：讀13、聽12、說18、寫21；IELTS：各項不得低於6.0)</p> </td> </tr> </table>	<p>美國 University of Southern California</p>	<p>TOEFL(iBT)90 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>	<p>美國 Savannah College of Arts and Design</p>	<p>TOEFL(iBT)85 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於20；IELTS：各項不得低於6.5)</p>	<p>加拿大 Sheridan College</p>	<p>TOEFL(iBT)88 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於21；IELTS：各項不得低於6.0)</p>	<p>英國 Teesside University</p>	<p>IELTS 6.0 以上證明。</p>	<p>法國 RUBIKA Valenciennes</p>	<p>TOEFL(iBT)45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</p>	<p>法國 Gobelins, l'École de l'image</p>	<p>TOEFL(iBT)45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</p>	<p>荷蘭 AKV St. Joost</p>	<p>TOEFL(iBT)80 或 IELTS 6.0 以上證明。</p>	<p>澳洲 RMIT University</p>	<p>TOEFL(iBT)79 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL 各項最低：讀13、聽12、說18、寫21；IELTS：各項不得低於6.0)</p>
<p>美國 University of Southern California</p>	<p>TOEFL(iBT)90 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>																
<p>美國 Savannah College of Arts and Design</p>	<p>TOEFL(iBT)85 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於20；IELTS：各項不得低於6.5)</p>																
<p>加拿大 Sheridan College</p>	<p>TOEFL(iBT)88 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於21；IELTS：各項不得低於6.0)</p>																
<p>英國 Teesside University</p>	<p>IELTS 6.0 以上證明。</p>																
<p>法國 RUBIKA Valenciennes</p>	<p>TOEFL(iBT)45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</p>																
<p>法國 Gobelins, l'École de l'image</p>	<p>TOEFL(iBT)45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</p>																
<p>荷蘭 AKV St. Joost</p>	<p>TOEFL(iBT)80 或 IELTS 6.0 以上證明。</p>																
<p>澳洲 RMIT University</p>	<p>TOEFL(iBT)79 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL 各項最低：讀13、聽12、說18、寫21；IELTS：各項不得低於6.0)</p>																
<p>注意事項</p>	<p>學生應自行檢查上述應繳交之各項文件是否正確齊全，如因表件不全、資格不符、逾期繳件而遭取消報名資格，應自行負責。</p>																

四、甄選方式等相關規定

組別	數位動畫組							
甄選資格	111 學年度各公私立大學校院大學部二年級以上，含研究所碩士班在學學生，具有中華民國國籍，且設有戶籍者。在完成國外進修培訓前，亦須具備國內學校之在學學生身分。							
培訓機構	美國 University of Southern California	美國 Savannah College of Arts and Design	加拿大 Sheridan College	英國 Teesside University	法國 RUBIKA Valenciennes	法國 Gobelins, l'École de l'image	荷蘭 AKV St. Joost	澳洲 RMIT University
領域	動畫創意 數位藝術 影視製作 (研究所)	角色動畫 動畫創作 美術設定 (研究所)	動畫短片 電腦動畫 動畫技術 (研究所)	數位動畫 動畫特效 動畫實務 (研究所)	電影特效 動畫實務 動畫電影 (專業學程)	電影動畫 動畫特效 動畫實務 (專業學程)	動畫實習 動畫藝術 動畫應用 (研究所)	動畫理論 數位創作 產業實習 (研究所)
招生名額	1	1	1	1	1	1	1	1
申請方式	<p>初審第一階段「國內研習營申請」審查及第二階段「國內研習營」 初審第一階段「國內研習營申請」依據報名時繳交資料進行審查。審查通過者，擇優遴選至多共 33 名參加研習營。研習營師資由海外培訓機構代表擔任。</p> <p>國內複審： 一、繳交各海外培訓機構要求門檻之語言成績影本、「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列國際競賽得獎證明影本（請參考最新版本、附錄二，無則免繳）及志願表。繳件期限為113 年 1 月 3 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期概不受理，未繳交者，視同放棄。 二、國內複審成績計算以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「國際競賽得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據。另語言成績作為國內複審名單審查門檻，不另計分。按學員之總成績名次及志願依序分發各海外培訓機構，選送各培訓機構錄取名額最多 4 倍之送審名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。 三、美國 Savannah、加拿大 Sheridan、英國 Teesside、法國 RUBIKA、法國 Gobelins 之培訓機構，須於初、複審中經審定 3D 技能合格者才予以分發。</p> <p>海外培訓機構決選： 海外培訓機構資料審查：合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本予承辦學校代為申請，進行決選。繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，由承辦學校另行公告之。</p>							
成績排序原則	<p>初審：第一階段「國內研習營申請」審查結果，總成績相同時，依序以 1. 「作品集」、2. 「語文成績」3. 「其他相關證明者」之成績比較，成績較高者優先錄取。</p> <p>複審：「海外培訓機構決選」合格名單審查，總成績相同時，依序以 1. 「國內研習營成績」、2. 「初審成績」比較，成績較高者優先錄取。</p>							
其他規定	學員錄取報到後，須依規定簽訂教育部「藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書」始得辦理出國進修，報名時請慎重考慮自身相關因素及規定，錄取後不得以任何理由申請資格保留。							
聯絡方式	Email: sposad@yuntech.edu.tw; 電話: (05)534-2601 分機 6593							
計畫目標	數位工具、媒體創意為新興文化創意產業與數位內容產業之核心，亦是目前國家發展計畫的重點產業。「數位動畫」領域結合科技、美學與文化，更是被看好的明星文化創意產業。近年來除了具有豐富製作經驗的美、日先進國家之外，其他開發中國家，也相繼投入可觀的國家資源推動本產業發展。因此，本計畫規劃以本領域海外知名學校為合作對象，以培育更多專業優秀人才。							

視覺傳達設計組

項目	頁數
一、培訓機構一覽表	16
二、甄選重要日程表	18
三、報名手續、應繳交證明文件及書面審查資料	19
四、徵選方式等相關規定	21



一、『視覺傳達設計組』培訓機構一覽表

機構	錄取名額	初審		國內複審	海外培訓機構決選
		第一階段 國內研習營申請	第二階段 國內研習營		
美國 ArtCenter College of Design	1	資料審查 (佔總成績 20%) *參考備註 1	研習營成績 (佔總成績 60%) 面試成績 (佔總成績 10%) *參考備註 3	國際競賽得獎證明 (佔總成績 10%) 海外各機構要求之 語言成績證明 (不另計分) *參考備註 4	國外培訓機構資料審查與 大學部 TOEFL(iBT) 80 ; 或 IELTS 6.5 以上、 研究所 TOEFL(iBT) 100 ; 或 IELTS 7.0 以上語言成績
美國 Pratt Institute	1				國外培訓機構規定資料與 大學部 TOEFL(iBT) 79 ; 或 IELTS 6.5 以上、 研究所 TOEFL(iBT) 85 ; 或 IELTS 6.5 以上語言成績
美國 Parsons the New School of Design	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 92 ; 或 IELTS 7.0 以上語言成績
法國 Gobelins, l'École de l'image	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 45 ; 或 IELTS 4.0 以上 ; 或 TCF 法語檢定初級以上語言成績
丹麥 Design School Kolding	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 83 ; 或 IELTS 6.5 以上語言成績
澳洲 Swinburne University	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 60(各項最低標準:讀10、聽9、說16、 寫19); 或 IELTS 6.0(各項不得低於5.5)以上語言成 績
日本 Musashino Art University	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 61 ; 或 IELTS 5.0 以上語言成績 ; 或 JLPT 三級以上語言成績

備註

- 1、國內初審分兩階段，第一階段「國內研習營申請」繳交文件與審查之各項計分比例為：
 - (1)學校推薦、個人申請：作品集 50%、語言能力證明 20%、其他有助審查之證明文件與資料 30%。
 - (2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：作品集、語言能力證明、其他有助審查之證明文件與資料。
- 2、初審第二階段研習營之錄取名單依第一階段「國內研習營申請」審查成績辦理：
 - (1)學校推薦、個人申請：錄取 30 名，備取 10 名。
 - (2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：至多錄取 3 名。
- 3、國內研習營除外師之術科評分外，並設有研習營規定，違反規定者扣分，併入計算總分。另於研習營期間擇日安排面試。
- 4、國內複審：繳交各培訓機構要求門檻之語言成績證明、「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」所列各項國際競賽得獎證明影本（請參考附錄二，無則免繳。本組僅採計「綜合設計類」及「視覺傳達設計類」獎項）及志願表。國際競賽得獎證明佔計分比例 10%，另語言成績為審查門檻不另計分。繳件期限為 **112 年 12 月 6 日(星期三)**前，以寄出時間為憑，逾期或未繳件概不受理，視同放棄。
- 5、語言成績除海外培訓機構在複審會議日期前公告受理 TOEFL My Best Scores 外，則一律不採用。
- 6、國內複審成績：以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「國際競賽得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據；並參考學員志願表挑選各培訓機構錄取名額最多 4 倍之合格名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。
- 7、複審合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料及海外培訓機構要求之語文能力證明參加決選。繳交日期依海外培訓機構期程另行公告調整之。
- 8、申請非英語系國家，雖無硬性規定須交當地國語言成績，仍需具當地國基礎語言才能妥善學習。
- 9、當外交部公告海外培訓機構所處地區為旅遊紅色警戒區時，教育部得不選送學員至該機構進修，雖有缺額亦不錄取。

二、『視覺傳達設計組』甄選重要日程表

作業事項	日期	說明
簡章公告	112年3月	
報名日期	即日起至112年5月31日(星期三)止	於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及指定資料，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。
繳交報名表件資料	即日起至112年5月31日(星期三)止	於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及指定資料，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。
公布初審第一階段合格名單與研習營入選通知	112年6月12日(星期一)	(依實際公告日為主)。 以E-mail通知第一階段「國內研習營申請」審查結果與研習營相關通知。
研習營正取生報到	於112年6月19日(星期一)前	將培訓同意書傳真或E-mail回報。
研習營備取生遞補	於112年6月21日(星期三)前	將培訓同意書傳真或E-mail回報。
國內研習營	1. 時間：112年7月3日(星期一)至7月14日(星期五)。 2. 地點：國立雲林科技大學。 3. 預計112年6月23日(星期五)前	公告課表於計畫網站，並由承辦學校協助研習學員報到與住宿安排。
公布研習營排	112年7月19日(星期三)	以E-mail寄發，並公告於計畫網站。
複審資料繳件日期	112年12月6日(星期三)前	※倘海外培訓機構更新期程，承辦學校將另行公告調整。
海外培訓機構申請資料繳交日期		於複審會議結果公告後，另行公告海外培訓機構申請截止日期。
海外培訓機構審核	113年1月至5月	
放榜及寄發正備取通知	預計113年6月14日(星期五)前	放榜，確實時間以海外學校公布決選結果彈性調整。
正取生報到	113年6月21日(星期五)前	
備取缺額公告	113年6月26日(星期三)前	
備取生報到	113年6月28日(星期五)前	

注意事項：

1. 本次甄選各項通知學生事項，均採E-mail通知及網站公告(網址：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/2023MOE/>)，必要時輔以掛號郵件郵寄。
2. 報名學生請注意「甄選重要日程表」各項作業時間；若於排定日程未接獲通知(E-mail)，請自行上網查詢或電話洽詢國立雲林科技大學—教育部菁培計畫總辦公室承辦人(05)534-2601分機6593。

三、報名手續、應繳交證明文件及書面審查資料

項 目	說 明
填寫報名表	請用正楷填寫報名表並確認無誤後，於簽名欄處由學生親自簽名。
繳交相片	本人最近三個月內，二吋半身脫帽正面照片一張（黏貼於報名表）。
繳交身分證影本與學生證影本	1. 身分證正反面影本，字跡應清晰可辨（浮貼於報名表）。 2. 學生證正反面影本，字跡應清晰可辨（應蓋妥 111 學年度第二學期註冊章，浮貼於報名表）。
國內初審第一階段應繳資料	<p>(一) 報名：一律採線上報名。請填寫本簡章報名表(附表二)，並於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及下列資料。各項資料送出前請確認完整無誤。</p> <p>(二) 初審第一階段：</p> <p>1. 學校推薦：</p> <p>(1) 大學(含)以上在校成績單，紙本成績單請以掃描方式提供，勿提供翻拍照片。</p> <p>(2) 作品集(足以證明其創作潛力的視覺傳達設計相關作品)。作品至少五件以上，請詳述作品理念與發展過程、成果展示及說明，包含構想圖、完成作品或成品照片，請以電子檔方式繳交。大小不得超過 A3 格式，並製作封面，內附相關之圖片、相片。作品集內若有團體作品，請註明個人於該作品之貢獻及組員人數、姓名。</p> <p>(3) 學校推薦公文。</p> <p>(4) 老師推薦函(附表六)。</p> <p>(5) 語言能力證明影本 (GEPT、TOEIC、TOEFL、IELTS、Cambridge、ESOL、日檢、法檢等)，若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單。</p> <p>(6) 其他有助於審查之證明文件與資料影本，將各類檔案彙整成一份檔案上傳。例如：特殊專長等證明、曾發表之作品、證照、獲獎紀錄等。</p> <p>2. 個人申請：</p> <p>(1) 大學(含)以上在校成績單。</p> <p>(2) 作品集(規範同學校推薦)。</p> <p>(3) 語言能力證明影本 (規範同學校推薦)。</p> <p>(4) 其他有助於審查之證明文件與資料影本(規範同學校推薦)。</p> <p>3. 獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：</p> <p>(1) 作品集 (規範同學校推薦)。</p> <p>(2) 語言能力證明影本 (規範同學校推薦)。</p> <p>(3) 其他有助於審查之證明文件與資料影本 (規範同學校推薦)。</p> <p>(三) 初審資料繳交期限： 至112年5月31日(星期三)止，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。</p> <p>註1：上述各項證明文件得繳交影本，惟若因所繳交之各項證件不符，或有偽造、假借、塗改等情事，即認定不具備報名資格。</p> <p>註2：報名所繳之表件及審查資料，由計畫辦公室留存備查。</p>

<p>國內複審應繳資料</p>	<p>(一) 書面資料審查：</p> <ol style="list-style-type: none"> 欲申請之海外培訓機構規定之語言成績證明（請參考當年度海外各培訓機構網站之最新公告標準）。繳件截止日期為112年12月6日(星期三)前，不接受補件，未繳交者，視同放棄（請參照附錄一 2023年語文檢定考試時程資料，並及早應考）。 「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」國際競賽得獎證明。（國際競賽一覽表依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「視覺傳達設計類」獎項）。 <p>(二) 志願表：申請本組學校標示研究所者，應於複審資料收件截止日前另提交國內研究所錄取證明，並不得列他校大學部為志願。</p>														
<p>海外培訓機構決選應繳資料</p>	<p>國內複審合格者須檢送英文作品集、英文研習計畫及相關英譯表件資料等，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本。由本組承辦學校郵寄海外培訓機構進行決選，繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，承辦學校於國內複審結果公告後另行公告。</p> <table border="1" data-bbox="351 694 1428 1433"> <tr> <td data-bbox="351 694 646 801"> <p>美國 ArtCenter College of Design</p> </td> <td data-bbox="646 694 1428 801"> <p>大學部：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="351 801 646 909"> <p>美國 Pratt Institute</p> </td> <td data-bbox="646 801 1428 909"> <p>大學部：TOEFL(iBT) 79 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 85 或 IELTS 6.5 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="351 909 646 1016"> <p>美國 Parsons the New School of Design</p> </td> <td data-bbox="646 909 1428 1016"> <p>TOEFL(iBT) 92 或 IELTS 7.0 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="351 1016 646 1124"> <p>法國 Gobelins, l'École de l'image</p> </td> <td data-bbox="646 1016 1428 1124"> <p>TOEFL(iBT) 45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="351 1124 646 1232"> <p>丹麥 Design School Kolding</p> </td> <td data-bbox="646 1124 1428 1232"> <p>TOEFL(iBT) 83 或 IELTS 6.5 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="351 1232 646 1339"> <p>澳洲 Swinburne University</p> </td> <td data-bbox="646 1232 1428 1339"> <p>TOEFL(iBT) 60 或 IELTS 6.0 以上證明。 (TOEFL 各項最低：讀 10、聽 9、說 16、寫 19；IELTS 各項不得低於 5.5)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="351 1339 646 1433"> <p>日本 Musashino Art University</p> </td> <td data-bbox="646 1339 1428 1433"> <p>TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上或 JLPT 三級以上證明</p> </td> </tr> </table>	<p>美國 ArtCenter College of Design</p>	<p>大學部：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7 以上證明。</p>	<p>美國 Pratt Institute</p>	<p>大學部：TOEFL(iBT) 79 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 85 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>	<p>美國 Parsons the New School of Design</p>	<p>TOEFL(iBT) 92 或 IELTS 7.0 以上證明。</p>	<p>法國 Gobelins, l'École de l'image</p>	<p>TOEFL(iBT) 45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</p>	<p>丹麥 Design School Kolding</p>	<p>TOEFL(iBT) 83 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>	<p>澳洲 Swinburne University</p>	<p>TOEFL(iBT) 60 或 IELTS 6.0 以上證明。 (TOEFL 各項最低：讀 10、聽 9、說 16、寫 19；IELTS 各項不得低於 5.5)</p>	<p>日本 Musashino Art University</p>	<p>TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上或 JLPT 三級以上證明</p>
<p>美國 ArtCenter College of Design</p>	<p>大學部：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7 以上證明。</p>														
<p>美國 Pratt Institute</p>	<p>大學部：TOEFL(iBT) 79 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 85 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>														
<p>美國 Parsons the New School of Design</p>	<p>TOEFL(iBT) 92 或 IELTS 7.0 以上證明。</p>														
<p>法國 Gobelins, l'École de l'image</p>	<p>TOEFL(iBT) 45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</p>														
<p>丹麥 Design School Kolding</p>	<p>TOEFL(iBT) 83 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>														
<p>澳洲 Swinburne University</p>	<p>TOEFL(iBT) 60 或 IELTS 6.0 以上證明。 (TOEFL 各項最低：讀 10、聽 9、說 16、寫 19；IELTS 各項不得低於 5.5)</p>														
<p>日本 Musashino Art University</p>	<p>TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上或 JLPT 三級以上證明</p>														
<p>注意事項</p>	<p>學生應自行檢查上述應繳交之各項文件是否正確齊全，如因表件不全、資格不符、逾期繳件而遭取消報名資格，應自行負責。</p>														

四、甄選方式等相關規定

組別	視覺傳達設計組						
甄選資格	111 學年度各公私立大學校院大學部二年級以上，含研究所碩士班在學學生，具有中華民國國籍，且設有戶籍者。在完成國外進修培訓前，亦須具備國內學校之在學學生身分。						
培訓機構	美國 ArtCenter College of Design	美國 Pratt Institute	美國 Parsons the New School of Design	法國 Gobelins, l'École de l'image	丹麥 Design School Kolding	澳洲 Swinburne University	日本 Musashino Art University
研究領域	視覺傳達 設計實務 設計管理 (大學、研究所)	視覺傳達 包裝設計 設計實務 (大學、研究所)	視覺傳達 互動媒體 設計思考 (大學、研究所)	動態設計 設計實務 傳達設計 (專業課程)	設計整合 創新實務 生活設計 (研究所)	視覺傳達 設計實務 媒體設計 (專業課程)	傳達設計 構成創作 設計實務 (專業課程)
招生名額	1	1	1	1	1	1	1
申請方式	<p>初審第一階段「國內研習營申請」審查及第二階段「國內研習營」 初審第一階段「國內研習營申請」依據報名時繳交資料進行審查。審查通過者，擇優遴選至多 33 名參加研習營。研習營師資由海外培訓機構代表擔任。</p> <p>國內複審： 一、繳交各海外培訓機構要求門檻之語言成績影本、「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列國際競賽得獎證明影本（請參考最新版本、附錄二，無則免繳）及志願表。繳件期限為 112 年 12 月 6 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期概不受理，未繳交者，視同放棄。 二、國內複審成績計算以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「國際競賽得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據。另語言成績作為國內複審名單審查門檻，不另計分。按學員之總成績名次及志願依序分發各海外培訓機構，選送各培訓機構錄取名額最多 4 倍之送審名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p> <p>海外培訓機構決選： 海外培訓機構資料審查：合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本予承辦學校代為申請，進行決選。繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，由承辦學校另行公告之。</p>						
	<p>成績排序原則 初審：第一階段「國內研習營申請」審查結果，總成績相同時，依序以 1. 「作品集」、2. 「語文成績」、3. 「其他相關證明者」之成績比較，成績較高者優先錄取。 複審：「海外培訓機構決選」合格名單審查，總成績相同時，依序以 1. 「國內研習營成績」、2. 「初審成績」比較，成績較高者優先錄取。</p>						
	<p>其他規定 學員錄取報到後，須依規定簽訂教育部「藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書」始得辦理出國進修，報名時請慎重考慮自身相關因素及規定，錄取後不得以任何理由申請資格保留。</p>						
聯絡方式	Email：sposad@yuntech.edu.tw；電話：(05)534-2601 分機 6593						
計畫目標	「視覺傳達設計」在各類商業活動中扮演重要的角色，任何產品與廣告透過設計者的巧思與創意，經由適當且美觀的設計、包裝後，就能提升產品整體的價值與效益。此外，現今消費市場追求更精緻且時尚的品牌服務、產品包裝、廣告和形象設計，視覺傳達設計相關產業已列為多項重點發展範疇。因此，本計畫規劃以本領域海外知名學校為合作對象，以培育更多專業優秀人才。						

產品設計組

項目	頁數
一、培訓機構一覽表	23
二、徵選重要日程表	25
三、報名手續、應繳交證明文件及書面審查資料	26
四、徵選方式等相關規定	28



一、『產品設計組』培訓機構一覽表

機構	錄取名額	初審(研習營)		國內複審	海外培訓機構決選
		第一階段 國內研習營申請	第二階段 國內研習營		
美國 ArtCenter College of Design	1	資料審查 (佔總成績 20%) * 參考備註 1	研習營成績 (佔總成績 60%) 面試 (佔總成績 10%) * 參考備註 3	國內競賽得獎證明 (佔總成績 10%) 海外各機構要求之 語言成績證明 (不另計分) * 參考備註 4	國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 80; 或 IELTS 6.5 以上語言成績
美國 College for Creative Studies	1				國外培訓機構規定資料與 大學部 TOEFL(iBT) 71; 或 IELTS 6.0 以上、 研究所 TOEFL(iBT) 80; 或 IELTS 6.5 以上語言成績
英國 Royal College of Art	1				國外培訓機構規定資料與 IELTS 6.5(寫作不得低於6.0, 其餘各項不得低於 5.5)以上語言成績
荷蘭 Delft University of Technology	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 100(各項不得低於22); 或 IELTS 7.0(各項不得低於6.5)以上語言成績
荷蘭 Eindhoven University of Technology	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 90(各項不得低於21); 或 IELTS 6.5(各項不得低於6.0)以上語言成績
德國 Weißensee Kunsthochschule Berlin	1				國外培訓機構規定資料與 德文檢定 A1 級; 或 TOEFL(iBT) 61; 或 IELTS 5.0 以上語言成績
澳洲 RMIT University	1				國外學校資料審查與 TOEFL(iBT) 79(各項最低標 準: 讀 13、聽 12、說 18、寫 21); 或 IELTS 6.5(各項不得低於 6.0)以上語言成 績
日本 Musashino Art University	1				國外培訓機構規定資料與 JLPT 2 級; 或 JLPT 3 級及 TOEFL iBT 61 或 IELTS 5.0 以上語言成績
日本 Chiba University	1				國外培訓機構規定資料與 150 小時以上日文修課證明; 或 TOEFL(iBT) 61; 或 IELTS 5.0 以上語言成績

備註

- 1、國內初審分兩階段，第一階段「國內研習營申請」繳交文件與審查之各項計分比例為：
 - (1)學校推薦、個人申請：作品集 50%、語言能力證明 20%、其他有助審查之證明文件與資料 30%。
 - (2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：作品集、語言能力證明、其他有助審查之證明文件與資料。
- 2、初審第二階段研習營之錄取名單依第一階段「國內研習營申請」審查成績辦理：
 - (1)學校推薦、個人申請：錄取 30 名，備取 10 名。
 - (2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：至多錄取 3 名。
- 3、國內研習營除外師之術科評分外，並設有研習營規定，違反規定者扣分，併入計算總分。另於研習營期間擇日安排面試。
- 4、國內複審：繳交各培訓機構要求門檻之語言成績證明、「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」國際競賽得獎證明影本（請參考附錄二，無則免繳。本組僅採計「綜合設計類」及「產品設計類」獎項）及志願表。國際競賽得獎證明佔計分比例 10%，另語言成績為審查門檻不另計分。繳件期限為 **112 年 12 月 6 日（星期三）** 前，以寄出時間為憑，逾期或未繳件概不受理，視同放棄。
- 5、語言成績除海外培訓機構在複審會議日期前公告受理 TOEFL My Best Scores 外，則一律不採用。
- 6、國內複審成績：以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「國際競賽得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據；並參考學員志願表挑選各培訓機構錄取名額最多 4 倍之合格名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。
- 7、複審合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料及海外培訓機構要求之語文能力證明參加決選。繳交日期依海外培訓機構期程另行公告調整之。
- 8、**英國 RCA、荷蘭 TUD、荷蘭 TU/e 為研究所課程；澳洲 RMIT 為榮譽學士課程，欲就讀該校學生須於海外研習期間具備國內研究所之學生身分。**
- 9、**美國 ArtCenter、德國 Weißensee、日本 Musashino 為學士課程，僅限大學部學生選填；美國 CCS、日本 Chiba 大學部及研究所學生皆可選填。**
- 10、申請非英語系國家，無硬性規定須交當地國語言成績者，仍需具當地國基礎語言才能妥善學習。
- 11、前往英國 RCA 進修者，申請英國學生簽證時需提出於 SELT(Secure English Language Testing)機構進行之英文考試成績如 IELTS UKVI。
- 12、當外交部公告海外培訓機構所處地區為旅遊紅色警戒區時，教育部得不選送學員至該機構進修，雖有缺額亦不錄取。

二、『產品設計組』甄選重要日程表

作業事項	日期	說明
簡章公告	112年3月	
報名日期	即日起至112年5月31日(星期三)止	於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及指定資料，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。
繳交報名表件資料	即日起至112年5月31日(星期三)止	於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及指定資料，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。
公布初審第一階段合格名單與研習營入選通知	112年6月12日(星期一)	(依實際公告日為主)。 以E-mail通知第一階段「國內研習營申請」審查結果與研習營相關通知。
研習營正取生報到	於112年6月19日(星期一)前	將培訓同意書傳真或E-mail回報。
研習營備取生遞補	於112年6月21日(星期三)前	將培訓同意書傳真或E-mail回報。
國內研習營	1. 時間：112年7月16日(星期日)至7月25日(星期二)。 2. 地點：國立成功大學。 3. 預計112年7月7日(星期五)前	公告課表於計畫網站，並由承辦學校協助研習學員報到與住宿安排。
公布研習營序	112年7月28日(星期五)	以E-mail寄發，並公告於計畫網站。
複審資料繳件日期	112年12月6日(星期三)前	※倘海外培訓機構更新期程，承辦學校將另行公告調整。
海外培訓機構申請資料繳交日期		於複審會議結果公告後，另行公告海外培訓機構申請截止日期。
海外培訓機構審核	113年1月至5月	
放榜及寄發正備取通知	預計113年6月14日(星期五)前	放榜，確實時間以海外學校公布決選結果彈性調整。
正取生報到	113年6月21日(星期五)前	
備取缺額公告	113年6月26日(星期三)前	
備取生報到	113年6月28日(星期五)前	

注意事項：

1. 本次甄選各項通知學員事項，均採E-mail通知及網站公告(網址：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/2023MOE/>)，必要時輔以掛號郵件郵寄。
2. 報名學生請注意「甄選重要日程表」各項作業時間；若於排定日程未接獲通知(E-mail)，請自行上網查詢或洽詢國立成功大學「工業設計系」教育部菁培計畫辦公室承辦人(06)275-7575分機54343。

三、報名手續、應繳交證明文件及書面審查資料

項 目	說 明
填寫報名表	請用正楷填寫報名表並確認無誤後，於簽名欄處由學生親自簽名。
繳交相片	本人最近三個月內，二吋半身脫帽正面照片一張（黏貼於報名表）。
繳交身分證影本與學生證影本	1. 身分證正反面影本，字跡應清晰可辨（黏貼於報名表背面）。 2. 學生證正反面影本，字跡應清晰可辨（應蓋妥 111 學年度第二學期註冊章，黏貼於報名表背面）。
國內初審第一階段應繳資料	<p>(一) 報名：一律採<u>線上報名</u>。請填寫本簡章報名表(附表三)，並於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及下列資料。各項資料送出前請確認完整無誤。</p> <p>(二) 初審第一階段：</p> <p>1. <u>學校推薦</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單，紙本成績單請以掃描方式提供，勿提供翻拍照片。 (2) 作品集（申請學生需提出足以證明其創作潛力的產品設計相關作品及設計類獲獎證明及證照等）。作品集內若有團體作品，請註明個人於該作品之貢獻及組員人數、姓名。 (3) 學校推薦公文。 (4) 老師推薦函（附表六）。 (5) 語言能力證明影本(GEPT、TOEIC、TOEFL、IELTS、CSEPT、Cambridge、ESOL、日檢、德檢等)，若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單。 (6) 其他有助於審查之證明文件與資料影本，將各類檔案彙整成一份檔案上傳。例如：特殊專長等證明、曾發表之作品、證照、獲獎紀錄等。 <p>2. <u>個人申請</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單。 (2) 作品集（規範同學校推薦）。 (3) 語言能力證明影本（規範同學校推薦）。 (4) 其他有助於審查之證明文件與資料影本（規範同學校推薦）。 <p>3. <u>獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 作品集（規範同學校推薦） (2) 語言能力證明影本（規範同學校推薦） (3) 其他有助於審查之證明文件與資料影本（規範同學校推薦） <p>(三) 初審資料繳交期限： 至 112 年 5 月 31 日(星期三)止，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。</p> <p>註1：上述各項證明文件得繳交影本，惟若因所繳交之各項證件不符，或有偽造、假借、塗改等情事，即認定不具備報名資格。</p> <p>註2：報名所繳之表件及審查資料，由計畫辦公室留存備查。</p>

<p>國內複審應繳資料</p>	<p>(一) 書面資料審查：</p> <ol style="list-style-type: none"> 欲申請之海外培訓機構規定之語言成績證明（請參考當年度海外各培訓機構網站之最新公告標準）。繳件截止日期為112年12月6日(星期三)前，不接受補件，未繳交者，視同放棄（請參照附錄一 2023 年語文檢定考試時程資料，並及早應考）。 「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」國際競賽得獎證明（國際競賽一覽表依照教育部最新公告版本為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「產品設計類」獎項）。 <p>(二) 志願表：申請本組學校標示研究所、榮譽學士者，應於複審資料收件截止日前另提交國內研究所錄取證明，並不得列他校大學部為志願。</p>																		
<p>海外培訓機構決選應繳資料</p>	<p>國內複審合格者須檢送英文作品集、英文研習計畫及相關英譯表件資料等，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本。由本組承辦學校郵寄海外培訓機構進行決選，繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，承辦學校於國內複審結果公告後另行公告。</p> <table border="1" data-bbox="379 719 1437 1597"> <tr> <td data-bbox="379 719 699 819"> <p>美國 ArtCenter College of Design</p> </td> <td data-bbox="699 719 1437 819"> <p>TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 819 699 920"> <p>美國 College for Creative Studies</p> </td> <td data-bbox="699 819 1437 920"> <p>大學部：TOEFL(iBT) 71 或 IELTS 6.0 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 920 699 1021"> <p>英國 Royal College of Art</p> </td> <td data-bbox="699 920 1437 1021"> <p>IELTS 6.5 以上證明。 (寫作不得低於 6.0，其餘各項不得低於 5.5)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 1021 699 1122"> <p>荷蘭 Delft University of Technology</p> </td> <td data-bbox="699 1021 1437 1122"> <p>TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7.0 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 22；IELTS：各項不得低於 6.5)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 1122 699 1223"> <p>荷蘭 Eindhoven University of Technology</p> </td> <td data-bbox="699 1122 1437 1223"> <p>TOEFL(iBT) 90 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 21；IELTS：各項不得低於 6.0)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 1223 699 1323"> <p>德國 Weißensee Kunsthochschule Berlin</p> </td> <td data-bbox="699 1223 1437 1323"> <p>德文檢定 A1 級 或 TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 1323 699 1424"> <p>澳洲 RMIT University</p> </td> <td data-bbox="699 1323 1437 1424"> <p>TOEFL(iBT) 79(各項最低標準：讀 13、聽 12、說 18、寫 21)； 或 IELTS 6.5(各項不得低於 6.0)以上語言成績。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 1424 699 1525"> <p>日本武藏野美術大學 Musashino Art University</p> </td> <td data-bbox="699 1424 1437 1525"> <p>JLPT2 級；或 JLPT3 級及 TOEFL(iBT)61 或 IELTS5.0 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 1525 699 1597"> <p>日本千葉大學 Chiba University</p> </td> <td data-bbox="699 1525 1437 1597"> <p>150 小時以上日文修課證明 或 TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上證明。</p> </td> </tr> </table>	<p>美國 ArtCenter College of Design</p>	<p>TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>	<p>美國 College for Creative Studies</p>	<p>大學部：TOEFL(iBT) 71 或 IELTS 6.0 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>	<p>英國 Royal College of Art</p>	<p>IELTS 6.5 以上證明。 (寫作不得低於 6.0，其餘各項不得低於 5.5)</p>	<p>荷蘭 Delft University of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7.0 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 22；IELTS：各項不得低於 6.5)</p>	<p>荷蘭 Eindhoven University of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 90 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 21；IELTS：各項不得低於 6.0)</p>	<p>德國 Weißensee Kunsthochschule Berlin</p>	<p>德文檢定 A1 級 或 TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上證明。</p>	<p>澳洲 RMIT University</p>	<p>TOEFL(iBT) 79(各項最低標準：讀 13、聽 12、說 18、寫 21)； 或 IELTS 6.5(各項不得低於 6.0)以上語言成績。</p>	<p>日本武藏野美術大學 Musashino Art University</p>	<p>JLPT2 級；或 JLPT3 級及 TOEFL(iBT)61 或 IELTS5.0 以上證明。</p>	<p>日本千葉大學 Chiba University</p>	<p>150 小時以上日文修課證明 或 TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上證明。</p>
<p>美國 ArtCenter College of Design</p>	<p>TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>																		
<p>美國 College for Creative Studies</p>	<p>大學部：TOEFL(iBT) 71 或 IELTS 6.0 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>																		
<p>英國 Royal College of Art</p>	<p>IELTS 6.5 以上證明。 (寫作不得低於 6.0，其餘各項不得低於 5.5)</p>																		
<p>荷蘭 Delft University of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7.0 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 22；IELTS：各項不得低於 6.5)</p>																		
<p>荷蘭 Eindhoven University of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 90 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 21；IELTS：各項不得低於 6.0)</p>																		
<p>德國 Weißensee Kunsthochschule Berlin</p>	<p>德文檢定 A1 級 或 TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上證明。</p>																		
<p>澳洲 RMIT University</p>	<p>TOEFL(iBT) 79(各項最低標準：讀 13、聽 12、說 18、寫 21)； 或 IELTS 6.5(各項不得低於 6.0)以上語言成績。</p>																		
<p>日本武藏野美術大學 Musashino Art University</p>	<p>JLPT2 級；或 JLPT3 級及 TOEFL(iBT)61 或 IELTS5.0 以上證明。</p>																		
<p>日本千葉大學 Chiba University</p>	<p>150 小時以上日文修課證明 或 TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上證明。</p>																		
<p>注意事項</p>	<p>學生應自行檢查上述應繳交之各項文件是否正確齊全，如因資料不全、資格不符、逾期繳件而遭取消資格，應自行負責。</p>																		

四、甄選方式等相關規定

組別	產品設計組									
甄選資格	111 學年度各大學校院大學部二年級以上，含研究所碩士班在學學生，具有中華民國國籍，且設有戶籍者。在完成國外進修培訓前，亦須具備國內學校之在學學生身分。									
培訓機構	美國 ArtCenter College of Design	美國 College for Creative Studies	英國 Royal College of Art	荷蘭 Delft University of Technology	荷蘭 Eindhoven University of Technology	德國 Weißensee Kunsthochschule Berlin	澳洲 RMIT University	日本 Musashino Art University	日本 Chiba University	
研究領域	產品設計 (大學)	產品設計 體驗設計 (大學或 研究所)	產品設計 (研究所)	整合設計 策略設計 互動設計 (研究所)	工業設計 (研究所)	產品設計 (大學)	工業設計 (榮譽學士)	工藝設計 工業設計 (大學)	產品設計 工業設計 (大學或 研究所)	
招生名額	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
申請方式	<p>初審第一階段「國內研習營申請」審查及第二階段「國內研習營」成績</p> <p>初審第一階段「國內研習營申請」依據報名時繳交資料進行審查。審查通過者，擇優遴選至多 33 名參加研習營。研習營師資由海外培訓機構代表擔任。</p>									
	<p>國內複審：</p> <p>一、繳交各海外培訓機構要求門檻之語言成績影本、「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列國際競賽得獎證明影本（請參考最新版本、附錄二，無則免繳）及志願表。繳件期限為 112 年 12 月 6 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期概不受理，未繳交者，視同放棄。</p> <p>二、國內複審成績計算以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「國際競賽得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據。另語言成績作為國內複審名單審查門檻，不另計分。按學員之總成績名次及志願依序分發各海外培訓機構，選送各培訓機構錄取名額最多 4 倍之送審名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p>									
	<p>海外培訓機構決選：</p> <p>海外培訓機構資料審查：合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本予承辦學校代為申請，進行決選。繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，由承辦學校另行公告之。</p>									
成績排序原則	<p>初審：第一階段「國內研習營申請」審查結果，總成績相同時，依序以 1. 「作品集」、2. 「語文成績」、3. 「其他相關證明者」之成績比較，成績較高者優先錄取。</p> <p>複審：「海外培訓機構決選」合格名單審查，總成績相同時，依序以 1. 「國內研習營成績」、2. 「初審成績」比較，成績較高者優先錄取。</p>									
其他規定	學員錄取報到後，須依規定簽訂教育部「藝術與設計國際進修獎學金行政契約書」始得辦理出國進修，報名時請慎重考慮自身相關因素及規定，錄取後不得以任何理由申請資格保留。									
聯絡方式	Email: idencku@gmail.com; 電話: (06) 275-7575 分機 54343									
計畫目標	本計畫規劃以本領域海外知名學校為合作對象，藉由海外培訓培養具國際性前瞻視野之學生，養成具備融合中外設計理念、擴展創新創意之設計才能，培育更多專業優秀人才。									

建築與景觀設計組

項目	頁數
一、培訓機構一覽表	30
二、徵選重要日程表	32
三、報名手續、應繳交證明文件及書面審查資料	33
四、徵選方式等相關規定	35



一、『建築與景觀設計組』培訓機構一覽表

機構	錄取名額	初審(研習營)		國內複審	海外培訓機構決選
		第一階段 國內研習營申請	第二階段 國內研習營		
美國 Syracuse University	1	資料審查 (佔總成績 20%) *參考備註 1	研習營成績 (佔總成績 60%) 面試 (佔總成績 10%) *參考備註 3	國際競賽得獎證明 (佔總成績 10%) 海外各機構要求之語 言成績證明 (不另計分) *參考備註 4	國外培訓機構規定資料 研究所TOEFL(iBT) 90 ; 或 IELTS Overall Band Score 7.0 以上語言成績
美國 Parsons the New School of Design	1				國外培訓機構規定資料與 研究所TOEFL(iBT) 92 ; 或 IELTS Overall Band Score 7.0 以上語言成績
英國 University College London	1				國外培訓機構規定資料與 研究所TOEFL(iBT) 92 ; 或 IELTS Overall Band Score 6.5 以上語言成績
英國 Cook Haffner Architecture Platform	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 75 ; 或 IELTS Overall Band Score 6.0 以上語言成績
英國 Cook Robotham Architectural Bureau	1				國外培訓機構規定資料與 大學部TOEFL(iBT) 75 ; 或 IELTS Overall Band Score 6.0 以上語言成績
法國 School of Architecture Parsis-Est	1				國外培訓機構規定資料與 法文檢定 DELF-B1 ;或 TOEFL(iBT) 61 以上語言成績及 150 小時以上法文修課證明
荷蘭 Delft University of Technology	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 100(各項不得低於22) ; 或 IELTS 7.0(各項不得低於6.5)以上語言成績

- 1、國內初審分兩階段，第一階段「國內研習營申請」繳交文件與審查之各項計分比例為：
 - (1)學校推薦、個人申請：作品集 50%、語言能力證明 20%、其他助審查之證明文件與資料 30%。
 - (2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：作品集、語言能力證明、其他有助審查之證明文件與資料。
- 2、初審第二階段研習營之錄取名單依第一階段「國內研習營申請」審查成績辦理：
 - (1)學校推薦、個人申請：錄取 30 名，備取 10 名。
 - (2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：至多錄取 3 名。
- 3、國內研習營除外師之術科評分外，並設有研習營規定，違反規定者扣分，併入計算總分。另於研習營期間擇日安排面試。
- 4、國內複審：繳交各培訓機構要求門檻之語言成績證明、「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」所列各項國際競賽得獎證明影本（請參考附錄二，無則免繳。本組僅採計「建築與景觀設計類」獎項）及志願表。國際競賽得獎證明佔計分比例 10%，另語言成績為審查門檻不另計分。繳件期限為 **112 年 12 月 6 日（星期三）前**，以寄出時間為憑，逾期或未繳件概不受理，視同放棄。
- 5、語言成績除海外培訓機構在複審會議日期前公告受理 TOEFL My Best Scores 外，則一律不採用。
- 6、國內複審成績：以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「國際競賽得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據；並參考學員志願表挑選各培訓機構錄取名額最多 4 倍之合格名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。
- 7、**美國 SU、英國 UCL、荷蘭 Delft 為研究所學程，法國 Paris-Est 為研究生交換學程，欲就讀該校學生須於海外研習期間具備國內研究所之學生身分。**
- 8、複審合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料及海外培訓機構要求之語文能力證明參加決選。繳交日期依海外培訓機構期程另行公告調整之。
- 9、申請非英語系國家，雖無硬性規定須交當地國語言成績，仍需具當地國基礎語言才能妥善學習。
- 10、前往英國單位研習者，申請英國簽證時需提出於 SELT(Secure English Language Testing)機構進行之英文考試成績如 IELTS UKVI。
- 11、當外交部公告海外培訓機構所處地區為旅遊紅色警戒區時，教育部得不選送學員至該機構進修，雖有缺額亦不錄取。

備註

二、『建築與景觀設計組』甄選重要日程表

作業事項	日期	說明
簡章公告	112年3月	
報名日期	即日起至112年5月31日(星期三)止	於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及指定資料，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。
繳交報名表件資料	即日起至112年5月31日(星期三)止	於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及指定資料，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。
公布初審第一階段合格名單與研習營錄取通知	112年6月12日(星期一)前	(依實際公告日為主) 以 E-mail 通知第一階段「國內研習營申請」審查結果與研習營相關通知。
研習營正取生報到	112年6月19日(星期一)前	將培訓同意書傳真或 E-mail 回報。
研習營備取生遞補	112年6月21日(星期三)前	將培訓同意書傳真或 E-mail 回報。
國內研習營	1. 時間：112年7月16日(星期日)至7月25日(星期二)。 2. 地點：國立成功大學。 3. 預計112年6月23日(星期五)前公告研習營報到須知於計畫網站，並 E-mail 通知，另由承辦學校協助研習學員報到與住宿安排。	
公布研習營排	112年7月28日(星期五)	以 E-mail 寄發，並公告於計畫網站。
複審資料繳件日期	112年12月6日(星期三)前	※倘海外培訓機構更新期程，承辦學校將另行公告調整。
海外培訓機構申請資料繳交日期		於複審會議結果公告後，另行公告海外培訓機構申請截止日期。
海外培訓機構審核	113年1月至5月	
放榜及寄發正備取通知	預計113年6月14日(星期五)前	放榜，確實時間以海外培訓機構公布決選結果彈性調整。
正取生報到	113年6月21日(星期五)前	
備取缺額公告	113年6月26日(星期三)前	
備取生報到	113年6月28日(星期五)前	

注意事項：

1. 本次甄選各項通知學員事項，主要採 E-mail 通知及網站公告 (網址：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/2023MOE/>)，必要時輔以掛號郵件郵寄。
2. 報名學員請注意「甄選重要日程表」各項作業時間；若於排定日程未接獲通知 (E-mail)，請自行上網查詢或電話洽詢國立成功大學「建築學系」教育部菁培計畫辦公室承辦人 (06) 275-7575 分機 50239。

三、報名手續、應繳交證明文件及書面審查資料

項 目	說 明
填寫報名表	請用正楷填寫報名表並確認無誤後，於簽名欄處由學生親自簽名。
繳交相片	本人最近三個月內，二吋半身脫帽正面照片一張（黏貼於報名表）。
繳交身分證影本與學生證影本	1. 身分證正反面影本，字跡應清晰可辨（黏貼於報名表背面）。 2. 學生證正反面影本，字跡應清晰可辨（應蓋妥 111 學年度第二學期註冊章，黏貼於報名表背面）。
國內初審第一階段應繳資料	<p>(一) 報名：一律採<u>線上報名</u>。請填寫本簡章報名表(附表四)，並於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及下列資料。各項資料送出前請確認完整無誤。</p> <p>(二) 初審第一階段：</p> <p>1. <u>學校推薦</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單，紙本成績單請以掃描方式提供，勿提供翻拍照片。 (2) 作品集（足以證明其創作潛力的建築與景觀設計相關專案或作品）。作品集內若有團體作品，請註明個人於該作品之貢獻及組員人數、姓名。 (3) 學校推薦公文。 (4) 老師推薦函（附表六）。 (5) 語言能力證明影本（GEPT、TOEIC、TOEFL、IELTS、CSEPT、Cambridge ESOL 等），若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單。 (6) 其他有助於審查之證明文件與資料影本，將各類檔案彙整成一份檔案上傳。例如：特殊專長等證明、曾發表之作品、證照、獲獎紀錄等。 <p>2. <u>個人申請</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單。 (2) 作品集(規範同學校推薦)。 (3) 語言能力證明影本(規範同學校推薦)。 (4) 其他有助於審查之證明文件與資料影本(規範同學校推薦)。 <p>3. <u>獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 作品集(規範同學校推薦)。 (2) 語言能力證明影本(規範同學校推薦)。 (3) 其他有助於審查之證明文件與資料影本(規範同學校推薦)。 <p>(三) 初審資料繳交期限： 至 112 年 5 月 31 日(星期三)止，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。</p> <p>註1：上述各項證明文件得繳交影本，惟若因所繳交之各項證件不符，或有偽造、假借、塗改等情事，即認定不具備報名資格。</p> <p>註2：報名所繳之表件及審查資料，由計畫辦公室留存備查。</p>

<p>國內複審應繳資料</p>	<p>(一) 書面資料審查：</p> <ol style="list-style-type: none"> 欲申請之海外培訓機構規定之語言成績證明(請參考當年度海外各培訓機構網站之最新公告標準)。繳件截止日期為112年12月6日(星期三)前，不接受補件，未繳交者，視同放棄(請參照附錄一 2023年語文檢定考試時程資料，並及早應考)。 「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」國際競賽得獎證明。(國際競賽一覽表依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「建築與景觀設計類」獎項)。 <p>(二) 志願表：申請本組學校標示研究者，應於複審資料收件截止日前另提交國內研究所錄取證明，並不得列他校大學部為志願。</p>														
<p>海外培訓機構決選應繳資料</p>	<p>國內複審合格者須檢送英文作品集、英文研習計畫、推薦函及相關英譯表件資料等，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本。由本組承辦學校郵寄海外培訓機構進行決選，繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，承辦學校於國內複審結果公告後另行公告。</p> <table border="1" data-bbox="375 739 1412 1433"> <tr> <td data-bbox="375 739 678 840">美國 Syracuse University</td> <td data-bbox="678 739 1412 840">TOEFL(iBT)90 或 IELTS Overall Band Score 7.0 以上證明。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 840 678 940">美國 Parsons the New School of Design</td> <td data-bbox="678 840 1412 940">TOEFL(iBT)92 或 IELTS Overall Band Core 7.0 以上語言成績</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 940 678 1041">英國 University College London</td> <td data-bbox="678 940 1412 1041">TOEFL(iBT)92 或 IELTS Overall Band Score 6.5 以上證明。 (TOEFL: 讀/寫 24 以上、聽/說 20 以上; IELTS: 各項成績 6.0 以上)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1041 678 1142">英國 Cook Haffner Architecture Platform</td> <td data-bbox="678 1041 1412 1142">TOEFL(iBT)75 或 IELTS Overall Band Score 6.0 以上證明。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1142 678 1243">英國 Cook Robotham Architectural Bureau</td> <td data-bbox="678 1142 1412 1243">TOEFL(iBT)75 或 IELTS Overall Band Score 6.0 以上證明。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1243 678 1344">法國 School of Architecture Paris-Est</td> <td data-bbox="678 1243 1412 1344">法文檢定 DELF-B1; 或 TOEFL(iBT)61 以上證明及 150 小時以上法文修課證明。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1344 678 1433">荷蘭 Delft University of Technology</td> <td data-bbox="678 1344 1412 1433">TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7.0 以上證明。 (TOEFL: 各項不得低於 22; IELTS: 各項不得低於 6.5)</td> </tr> </table>	美國 Syracuse University	TOEFL(iBT)90 或 IELTS Overall Band Score 7.0 以上證明。	美國 Parsons the New School of Design	TOEFL(iBT)92 或 IELTS Overall Band Core 7.0 以上語言成績	英國 University College London	TOEFL(iBT)92 或 IELTS Overall Band Score 6.5 以上證明。 (TOEFL: 讀/寫 24 以上、聽/說 20 以上; IELTS: 各項成績 6.0 以上)	英國 Cook Haffner Architecture Platform	TOEFL(iBT)75 或 IELTS Overall Band Score 6.0 以上證明。	英國 Cook Robotham Architectural Bureau	TOEFL(iBT)75 或 IELTS Overall Band Score 6.0 以上證明。	法國 School of Architecture Paris-Est	法文檢定 DELF-B1; 或 TOEFL(iBT)61 以上證明及 150 小時以上法文修課證明。	荷蘭 Delft University of Technology	TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7.0 以上證明。 (TOEFL: 各項不得低於 22; IELTS: 各項不得低於 6.5)
美國 Syracuse University	TOEFL(iBT)90 或 IELTS Overall Band Score 7.0 以上證明。														
美國 Parsons the New School of Design	TOEFL(iBT)92 或 IELTS Overall Band Core 7.0 以上語言成績														
英國 University College London	TOEFL(iBT)92 或 IELTS Overall Band Score 6.5 以上證明。 (TOEFL: 讀/寫 24 以上、聽/說 20 以上; IELTS: 各項成績 6.0 以上)														
英國 Cook Haffner Architecture Platform	TOEFL(iBT)75 或 IELTS Overall Band Score 6.0 以上證明。														
英國 Cook Robotham Architectural Bureau	TOEFL(iBT)75 或 IELTS Overall Band Score 6.0 以上證明。														
法國 School of Architecture Paris-Est	法文檢定 DELF-B1; 或 TOEFL(iBT)61 以上證明及 150 小時以上法文修課證明。														
荷蘭 Delft University of Technology	TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7.0 以上證明。 (TOEFL: 各項不得低於 22; IELTS: 各項不得低於 6.5)														
<p>注意事項</p>	<p>學生應自行檢查上述應繳交之各項文件是否正確齊全，如因資料不全、資格不符、逾期繳件而遭取消資格，應自行負責。</p>														



四、甄選方式等相關規定

組別	建築與景觀設計組						
甄選資格	111 學年度各公私立大學校院大學部二年級以上或研究所碩士班在學學生，具有中華民國國籍，且設有戶籍者。在完成國外進修培訓前，亦須具備國內學校之在學學生身分。						
培訓機構	美國 Syracuse University	美國 Parsons the New School of Design	英國 University College London	英國 Cook Haffner Architecture Platform	英國 Cook Robotham Architectural Bureau	法國 School of Architecture Paris-Est	荷蘭 Delft University of Technology
研究領域	建築設計 建成環境 (研究所)	建築設計 (研究所)	生技整合建築 設計 (研究所)	建築設計、 景觀環境設計 (產業實習)	建築設計、 景觀環境設計 (產業實習)	建築設計 (碩士交換學程)	建築設計、都 市設計、景觀 建築、環境管 理、建築科技 (研究所)
招生名額	1	1	1	1	1	1	1
申請方式	<p>初審第一階段「國內研習營申請」審查及第二階段「國內研習營」成績 初審第一階段「國內研習營申請」依據報名時繳交資料進行審查。審查通過者，擇優遴選至多 33 名參加研習營。研習營師資由海外培訓機構代表擔任。</p> <p>國內複審： 一、繳交各海外培訓機構要求門檻之語言成績影本、「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列國際競賽得獎證明影本（請參考最新版本、附錄二，無則免繳）及志願表。繳件期限為112 年 12 月 6 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期概不受理，未繳交者，視同放棄。 二、國內複審成績計算以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「國際競賽得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據。另語言成績作為國內複審名單審查門檻，不另計分。按學員之總成績名次及志願依序分發各海外培訓機構，選送各培訓機構錄取名額最多 4 倍之送審名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p> <p>海外培訓機構決選： 海外培訓機構資料審查：合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本予承辦學校代為申請，進行決選。繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，由承辦學校另行公告之。</p>						
成績排序原則	<p>初審：第一階段「國內研習營申請」審查結果，總成績相同時，依序以 1. 「作品集」、2. 「語文成績」、3. 「其他相關證明者」之成績比較，成績較高者優先錄取。</p> <p>複審：「海外培訓機構決選」合格名單審查，總成績相同時，依序以 1. 「國內研習營成績」、2. 「初審成績」比較，成績較高者優先錄取。</p>						
其他規定	學員錄取報到後，須依規定簽訂教育部「藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書」始得辦理出國進修，報名時請慎重考慮自身相關因素及規定，錄取後不得以任何理由申請資格保留。						
聯絡方式	Email : sposad.ald@gmail.com ; 電話 : (06) 275-7575 分機 50239						
計畫目標	本計畫規劃以本領域海外知名學校及機構為合作對象，藉由海外培訓培養具國際性及前瞻視野學生，並透過中外設計理念之融合，孕育多元文化與科技創意、建築與景觀設計之跨域藝術人才。						

時尚設計組

項目	頁數
一、培訓機構一覽表	37
二、徵選重要日程表	38
三、報名手續、應繳交證明文件及書面審查資料	39
四、徵選方式等相關規定	41



一、『時尚設計組』培訓機構一覽表

機構	錄取名額	初審(研習營)		國內複審	海外培訓機構決選
		第一階段 國內研習營申請	第二階段 國內研習營		
美國 Parsons the New School of Design	1	資料審查 (佔總成績 20%) *參考備註 1	研習營成績 (佔總成績 60%) 面試成績 (佔總成績 10%) *參考備註 3	國際競賽得獎證明 (佔總成績 10%) 海外各機構要求之 語言成績證明 (不另計分) *參考備註 4	國外培訓機構規定資料 TOEFL(iBT) 92; 或 IELTS 7.0 以上語言成績
英國 Royal College of Art	1				國外培訓機構規定資料與 IELTS 6.5 以上語言成績 (寫作需達 6.0)
韓國 Ewha Womans University	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT)80; 或 IELTS 6.0; 或韓檢 TOPIK 三 級以上語言成績

- 備註
- 國內初審分兩階段，第一階段「國內研習營申請」繳交文件與審查之各項計分比例為：
 - 學校推薦、個人申請：作品集 50%、語言能力證明 20%、其他有助審查之證明文件與資料 30%。
 - 獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：作品集、語言能力證明、其他有助審查之證明文件與資料。
 - 初審第二階段研習營錄之取名單依第一階段「國內研習營申請」審查成績辦理：
 - 學校推薦、個人申請：錄取 20 名，備取 6 名。
 - 獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：至多錄取 3 名。
 - 國內研習營除外師之術科評分外，並設有研習營規定，違反規定者扣分，併入計算總分。另於研習營期間擇日安排面試。
 - 國內複審：繳交各培訓機構要求門檻之語言成績證明、「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」所列各項國際競賽得獎證明影本（請參考附錄二，無則免繳。本組僅採計「綜合設計類」及「時尚設計類」獎項）及志願表。國際競賽得獎證明佔計分比例 10%，另語言成績為審查門檻不另計分。繳件期限為 **112 年 12 月 6 日(星期三)**前，以寄出時間為憑，逾期或未繳件概不受理，視同放棄。
 - 語言成績除海外培訓機構在複審會議日期前公告受理 TOEFL My Best Scores 外，則一律不採用。
 - 國內複審成績：以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「國際競賽得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據；並參考學員志願表挑選各培訓機構錄取名額最多 4 倍之合格名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。
 - 複審合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料及海外培訓機構要求之語文能力證明參加決選。繳交日期依海外培訓機構期程另行公告調整之。
 - 申請非英語系國家，雖無硬性規定須交當地國語言成績，仍需具當地國基礎語言才能妥善學習。
 - 前往英國 RCA 進修者，申請英國學生簽證時需提出於 SELT(Secure English Language Testing)機構進行之英文考試成績如 IELTS UKVI。
 - 當外交部公告海外培訓機構所處地區為旅遊紅色警戒區時，教育部得不選送學員至該機構進修，雖有缺額亦不錄取。

二、『時尚設計組』甄選重要日程表

作業事項	日期	說明
簡章公告	112年3月	
報名日期	即日起至112年5月31日(星期三)止	於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及指定資料，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。
繳交報名表件資料	即日起至112年5月31日(星期三)止	於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及指定資料，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。
公布初審第一階段合格名單與研習營錄取通知	112年6月12日(星期一)	(依實際公告日為主)。 以E-mail通知第一階段「國內研習營申請」審查結果與研習營相關通知。
研習營正取生報到	於112年6月19日(星期一)前	將培訓同意書傳真或E-mail回報。
研習營備取生遞補	於112年6月21日(星期三)前	將培訓同意書傳真或E-mail回報。
國內研習營	1. 時間：112年7月3日(星期一)至7月14日(星期五)。 2. 地點：台南應用科技大學。 3. 預計112年6月23日(星期五)前	公告課表於計畫網站，並由承辦學校協助研習學員報到與住宿安排。
公布研習營排	112年7月19日(星期三)	以E-mail寄發，並公告於計畫網站。
臺北時裝週協助規定	配合文化部10月辦理之「2023臺北時裝週SS24」	，研習營成績排名前6名學員之作品將安排於時裝週展出。
複審資料繳件日期	112年12月6日(星期三)前	※倘海外培訓機構更新期程，承辦學校將另行公告調整。
海外培訓機構申請資料繳交日期		於複審會議結果公告後，另行公告海外培訓機構申請截止日期。
海外培訓機構審核	113年1月至5月	
放榜及寄發正備取通知	預計113年6月14日(星期五)前	放榜，確實時間以海外培訓機構公布決選結果彈性調整。
正取生報到	113年6月21日(星期五)前	
備取缺額公告	113年6月26日(星期三)前	
備取生報到	113年6月28日(星期五)前	

注意事項：

1. 本次甄選各項通知學生事項，均採E-mail通知及網站公告(網址：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/2023MOE/>)，必要時輔以掛號郵件郵寄。
2. 報名學生請注意「甄選重要日程表」各項作業時間；若於排定日程未接獲通知(E-mail)，請自行上網查詢或電話洽詢國立雲林科技大學—教育部菁培計畫總辦公室承辦人(05)534-2601分機6593。

三、報名手續、應繳交證明文件及書面審查資料

項	目	說	明
填寫報名表		請用正楷填寫報名表並確認無誤後，於簽名欄處由學生親自簽名。	
繳交相片		本人最近三個月內，二吋半身脫帽正面照片一張（黏貼於報名表）。	
繳交身分證影本與學生證影本		1. 身分證正反面影本，字跡應清晰可辨（浮貼於報名表）。 2. 學生證正反面影本，字跡應清晰可辨（應蓋妥 111 學年度第二學期註冊章，浮貼於報名表）。	
		<p>(一) 報名：一律採線上報名。請填寫本簡章報名表(附表五)，並於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及下列資料。各項資料送出前請確認完整無誤。</p> <p>(二) 初審第一階段：</p> <p>1. 學校推薦：</p> <p>(1) 大學(含)以上在校成績單，紙本成績單請以掃描方式提供，勿提供翻拍照片。</p> <p>(2) 作品集：作品至少 5 件以上，詳述作品理念與發展過程、成果展示及說明，包含構想圖(以照片及文字呈現深入研究、設計發展過程、材質與實驗)、完成作品及成品照片，製作封面且大小不得超過 A3 格式。作品集內若有團體作品，請註明個人於該作品之貢獻及組員人數、姓名。</p> <p>(3) 介紹影片：自錄至長 5 分鐘的介紹影片，介紹所提作品集內之作品一件，除作品特寫鏡頭外，本人及作品需同時入鏡，可剪接無需一鏡到底。介紹過程中，請包含至少 15 秒的 360 度視角拍攝作品全貌。自述內容應有服裝版型、用料材質、手法技術、細節及特有的重點，可於畫面上打上文字輔助提示。影片格式：至少 HD720 解析度，mp4 或 mov 格式。</p> <p>(4) 學校推薦公文。</p> <p>(5) 老師推薦函(附表六)。</p> <p>(6) 語言能力證明影本(GEPT、TOEIC、TOEFL、IELTS、Cambridge ESOL、日檢、韓檢、法檢等)，若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單。</p> <p>(7) 其他有助於審查之證明文件與資料影本，將各類檔案彙整成一份檔案上傳。例如：品牌行銷企劃、特殊專長等證明、曾發表之作品、證照、獲獎紀錄等。</p> <p>2. 個人申請：</p> <p>(1) 大學(含)以上在校成績單。</p> <p>(2) 作品集(規範同學校推薦)。</p> <p>(3) 介紹影片(規範同學校推薦)。</p> <p>(4) 語言能力證明影本(規範同學校推薦)。</p> <p>(5) 其他有助於審查之證明文件與資料影本(規範同學校推薦)。</p> <p>3. 獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：</p> <p>(1) 作品集(規範同學校推薦)。</p> <p>(2) 介紹影片(規範同學校推薦)。</p> <p>(3) 語言能力證明影本(規範同學校推薦)。</p> <p>(4) 其他有助於審查之證明文件與資料影本(規範同學校推薦)。</p> <p>(三) 初審資料繳交期限： 至 112 年 5 月 31 日(星期三)止，系統自動截止關閉，逾期恕不受理。</p>	
	國內初審第一階段應繳資料		
		<p>註 1：上述各項證明文件得繳交影本，惟若因所繳交之各項證件不符，或有偽造、假借、塗改等情事，即認定不具備報名資格。</p> <p>註 2：報名所繳之表件及審查資料，不論錄取與否，一律不予退還，請自留原件。</p>	

<p>國內複審應繳資料</p>	<p>(一) 書面資料審查：</p> <ol style="list-style-type: none"> 欲申請之海外培訓機構規定之語言成績證明(請參考當年度海外各培訓機構網站之最新公告標準)。繳件截止日期為112年12月6日(星期三)前，不接受補件，未繳交者，視同放棄(請參照附錄一2023年語文檢定考試時程資料，並及早應考)。 「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」國際競賽得獎證明(國際競賽一覽表依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「時尚設計類」獎項)。 <p>(二) 志願表：申請本組學校標示研究所者，應於複審資料收件截止日前另提交國內研究所錄取證明，並不得列他校大學部為志願。</p>						
<p>海外培訓機構決選應繳資料</p>	<p>國內複審合格者須檢送英文作品集、英文研習計畫及相關英譯表件資料等，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本。由本組承辦學校郵寄海外培訓機構進行決選，繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，承辦學校於國內複審結果公告後另行公告。</p> <table border="1" data-bbox="338 705 1428 1131"> <tr> <td data-bbox="338 705 571 846"> <p>美國 Parsons the New School for Design</p> </td> <td data-bbox="571 705 1428 846"> <p>TOEFL(iBT)92 或 IELTS 7.0 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 846 571 987"> <p>英國 Royal College of Art</p> </td> <td data-bbox="571 846 1428 987"> <p>IELTS 6.5(寫作需達6.0)以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 987 571 1131"> <p>韓國 Ewha Womans University</p> </td> <td data-bbox="571 987 1428 1131"> <p>TOEFL(iBT)80 或 IELTS6.0；或韓檢 TOPIK 三級以上證明。</p> </td> </tr> </table>	<p>美國 Parsons the New School for Design</p>	<p>TOEFL(iBT)92 或 IELTS 7.0 以上證明。</p>	<p>英國 Royal College of Art</p>	<p>IELTS 6.5(寫作需達6.0)以上證明。</p>	<p>韓國 Ewha Womans University</p>	<p>TOEFL(iBT)80 或 IELTS6.0；或韓檢 TOPIK 三級以上證明。</p>
<p>美國 Parsons the New School for Design</p>	<p>TOEFL(iBT)92 或 IELTS 7.0 以上證明。</p>						
<p>英國 Royal College of Art</p>	<p>IELTS 6.5(寫作需達6.0)以上證明。</p>						
<p>韓國 Ewha Womans University</p>	<p>TOEFL(iBT)80 或 IELTS6.0；或韓檢 TOPIK 三級以上證明。</p>						
<p>注意事項</p>	<p>學生應自行檢查上述應繳交之各項文件是否正確齊全，如因表件不全、資格不符、逾期繳件而遭取消報名資格，應自行負責。</p>						

四、甄選方式等相關規定

組別	時尚設計組		
甄選資格	111 學年度各公立大學校院大學部二年級以上，含研究所碩士班在學學生，具有中華民國國籍，且設有戶籍者。在完成國外進修培訓前，亦須具備國內學校之在學學生身分。		
培訓機構	美國 Parsons the New School for Design	英國 Royal College of Art	韓國 Ewha Womans University
課程	服裝設計 時尚創意 時尚產業連結 (大學、研究所)	男女服裝設計 織品設計 時尚產業實習 (研究所)	東方時尚 纖維紡織 時尚產業連結 (專業學程)
招生名額	1	1	1
申請方式	初審：第一階段「國內研習營申請」及第二階段「國內研習營」成績 初審第一階段「國內研習營申請」依據報名時繳交資料進行審查。審查通過者，擇優遴選至多共 23 名參加研習營。研習營師資由海外培訓機構代表擔任。		
	國內複審： 一、繳交各海外培訓機構要求門檻之語言成績影本、「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列國際競賽得獎證明影本（請參考最新版本、附錄二，無則免繳）及志願表。繳件期限為 112 年 12 月 6 日(星期三)前 ，以寄出時間為憑，逾期概不受理，未繳交者，視同放棄。 二、國內複審成績計算以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「國際競賽得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據。另語言成績作為國內複審名單審查門檻，不另計分。按學員之總成績名次及志願依序分發各海外培訓機構，選送各培訓機構錄取名額最多 4 倍之送審名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。		
	海外培訓機構決選： 海外培訓機構資料審查：合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本予承辦學校代為申請，進行決選。繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，由承辦學校另行公告之。		
成績排序原則	初審：第一階段「國內研習營申請」審查結果 ，總成績相同時，依序以 1. 「作品集」、2. 「語文成績」、3. 「其他相關證明者」之成績比較，成績較高者優先錄取。 複審：「海外培訓機構決選」合格名單審查 ，總成績相同時，依序以 1. 「國內研習營成績」、2. 「初審成績」比較，成績較高者優先錄取。		
其他規定	學員錄取報到後，須依規定簽訂教育部「藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書」始得辦理出國進修，報名時請慎重考慮自身相關因素及規定，錄取後不得以任何理由申請資格保留。		
聯絡方式	Email：sposad@yuntech.edu.tw；電話：(05)534-2601 分機 6593		
計畫目標	「時尚設計」對於國家時尚產業發展具有絕對的影響。時尚設計除了能將傳統紡織工業提升到新的經濟層次外，更能藉由創新以及個人風格注入到傳統產業之中，進而做到提升國力、陶冶藝術人文發展。全球時尚產業於近一世紀的發展，造就舉世聞名的紐約、巴黎、倫敦時裝週等國際盛會，其中涉及的各項專業技術和領域知能，更代表各國文化創意產業競爭的軟實力。因此，本計畫規劃以本領域海外知名學校為合作對象，以培育更多專業優秀人才。		

一、JLPT 日本語能力試驗

日本語能力試驗(JLPT®)由日本國際交流基金會與日本國際教育支援協會共同舉辦，為一國際性測驗，供世界各國日語學習者及日語使用者用以檢測所具日語能力。臺灣考區由日本臺灣交流協會、日本國際交流基金會及語言訓練測驗中心主辦，一年辦理兩次，於每年7月及12月第一個週日舉行。

測驗共分5個級數，由難至易依序為N1 - N5。報考者可依自己的能力選擇適合的級數參加。

測驗成績可作為學習評量、入學甄選及求職時之日語能力證明，合格者可取得國際認證之合格證書。另有意赴日就讀大學者請依學校要求報考「日本留學試驗」。

「日本語能力試驗」相關資訊請查閱「日本語能力試驗公式ウェブサイト」，網址：
<http://www.jlpt.jp/>。

- 測驗級數及測驗時間：N1、N2 在下午舉行；N3、N4、N5 在上午舉行。
- 測驗地點：台北、桃園、台中、高雄
- 測驗費：N1~N3 每名 1,600 元；N4、N5 每名 1,500 元

※日語檢定測驗日期，請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。

參考網址：<https://reg.lttc.org.tw/JLPT/>

二、TOEFL iBT 托福網路測驗

TOEFL iBT® 托福網路測驗是透過網路連線並利用電腦進行作答的測驗，考生必需使用耳機與麥克風，並使用電腦鍵盤在電腦上回答問題，測驗考生的聽、說、讀、寫四種技巧的能力，每個測驗技巧獨立計分，分數介於 0 至 30 之間，總分於介於 0 至 120 分之間，測驗時間大約為 4 個小時，主要在評量中階(intermediate)至高階(advanced)之英語能力。

各項測驗說明如下：

Section	Time Limit	Questions	Tasks
Reading*	60 - 80 minutes	36 - 56 questions	Read 3 or 4 passages from academic texts and answer questions.
Listening	60 - 90 minutes	34 - 51 questions	Listen to lectures, classroom discussions and conversations, then answer questions.
Break	10 minutes	—	—
Speaking	20 minutes	6 tasks	Express an opinion on a familiar topic; speak based on reading and listening tasks.
Writing	Writing	Writing	Writing

TOEFL iBT® 托福網路測驗除了評量考生瞭解英語的能力，更要評量考生使用英語的能力，故題目型態為整合式出題，測驗考生如何結合聽、說、讀、寫四種技巧，以證考生能適應日後在英語系國家之課堂及校園中可能遇到的情況。

※ TOEFL iBT 測驗日期，請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。

參考網址：<http://www.toeflgoanywhere.org/taiwan/index.php>



三、IELTS 雅思國際英語測驗系統

IELTS 雅思國際英語測驗系統 (The International English Language Testing System)，是由劍橋大學英語考試院設計用來評估欲前往英語系國家求學、移民或工作者在聽、說、讀、寫四項全方位英語的溝通能力，與托福同樣為全球廣泛接受的英語測驗。

全球有超過 9,000 所的各式機構或組織採用 IELTS 雅思成績，大多數英語系國家，如：澳洲、英國、紐西蘭、加拿大及德國等高等學府都偏好此英語能力認證；此外，美國現今已有超過 3,000 所大學院校承認 IELTS 雅思成績，含美國十大知名院校在內的高等學府，都接受 IELTS 成績作為申請入學者須提供的英語能力證明。

IELTS 雅思考試分為兩個組別：學術組 (Academic) 及一般訓練組 (General Training)。欲前往國外學術機構就讀的同學，請準備學術組的考試。

學術組 (ACADEMIC)	一般訓練組 (GENERAL TRAINING)
考題傾向用來評估考生是否適合以英語作為學習或培訓的媒介。適用於欲申請正式課程者，如研究所、大學、專科或學校要求此組別之成績者 (如：交換學生課程)。	考題則較適合以非學位取得為目的及欲申請移民或前往英語系國家工作的考生。

所有考生均須一次參加聽力、閱讀、寫作和口說共四個部份測試。學術組和一般訓練組的聽力和口說是使用相同的考題，閱讀和寫作則使用不同考題。筆試 (聽力、閱讀和寫作) 必須在同一天內完成，進行時間是從早上 08:30 到中午 12:30。口試將於筆試當日下午或他日舉行。根據全球 IELTS 雅思考試規定，在筆試進行時，沒有中場休息時間。

IELTS for UKVI

2015 年 2 月 20 日，英國政府宣佈了簽證類安全英語語言考試 (SELT) 的重要變動。準備辦理赴英居留或移民簽證者，需瞭解由英國簽證與移民局所頒佈的最新政策。欲前往英國或在英國居留一段時間者，可參加專門推出的雅思考試。

在申請多種簽證類別時，必須提交英國內政部移民署 (UK Visas and Immigration, UKVI) 認可的安全英語語言考試名單 (簡稱 SELT) 中所列測驗項目的成績。用於英國簽證及移民的雅思考試及雅思生活技能類考試均在此名單中。

用於英國簽證及移民的雅思考試是為滿足英國內政部移民署所規定的特殊操作性要求而開設的考試。倘需使用雅思成績作為申請英國簽證的一部分 (一些學生簽證類型除外)，則需在英國內政部移民署 (UK Visas and Immigration, UKVI) 授權的雅思考點參加考試。

※ IELTS 雅思測驗日期，請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。

參考網址：<https://www.ielts.org/>
<https://www.ieltstest.org.tw/>
<http://www.ieltstaiwan.org/>

四、TCF 法語檢定測驗

介紹

TCF 為一項基本法語能力測驗，用來檢測及鑑定非法語人士的法語程度，不論是為了個人的、工作上的或是就學的目的，分為六個等級：A1/A2/B1/B2/C1/C2。TCF 效期為 2 年。

測驗項目

TCF 測驗分為必考科目（由三個連續的部份組成）與兩個加考科目（口語與寫作）

必考科目			加考科目	
聽力：29 題 25 分鐘	語言結構：18 題 15 分鐘	閱讀：29 題 45 分鐘	口語：12 分鐘	寫作：1 小時
76 題/1h25				

考試報名方式

現場報名	郵寄報名	線上報名
現場報名請準備身份證件正反面影本、填寫報名表並至台北中心繳交費用。	郵寄報名請將以下文件於截止日前以雙掛號寄至台北中心 <ul style="list-style-type: none">- 填妥報名表並簽名- 身份證件正反面或護照影本- 郵政匯票（抬頭請註明社團法人台灣法國文化協會）	1. 請在下面選擇您的考試梯次 2. 點選“線上報名” 3. 依照指示建立帳號並進行線上付款。 4. 付款完成後，請將身分證或護照檔案、報名表與付款收據以 PDF 檔案格式電郵至 exam@alliancefrancaise.org.tw

考試注意事項

考試請攜帶准考證、身分證或護照（其餘證件概不受理）以及黑色原子筆應考。考生最晚應於考前 10 分鐘進入考場準備。

TCF 法語檢定測驗測驗日期，請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。

<https://www.alliancefrancaise.org.tw/services/tcf-zh/>

五、DELF-DALF®官方法語鑑定文憑

DELF-DALF®官方法語鑑定文憑

DELF / DALF 為法國教育部唯一認可的官方法語鑑定文憑。

本測驗(DELF-DALF Tout public 普通版)依據歐洲語言共同參考架構，共分6個級數，由難至易依序為C2-C1-B2-B1-A2-A1。報考者可依自己的能力選擇適合的級數參加。DELF / DALF 鑑定文憑終生有效。同一級數通過者即無法再次報考，例如已通過 DELF PRO B1 者，之後只能報考 DELF(普通版)A1/A2/B2/C1/C2 級數考試。

本測驗成績為法國高等教育申請入學門檻，自2008年起，如欲申請大學且擁有 DELF B2 鑑定文憑，無需參加其他法語測驗。

相關資訊請查閱臺灣法國文化協會，網址：<http://www.alliancefrancaise.org.tw/>。

DELF / DALF 所有試題之設計皆經過嚴謹程序審核(由法國國際教學研究人員評估、審核及制定)；而測驗中所有試題委員、閱卷官與口試官皆受過專業訓練並獲適任證明。各級數皆包含以下四類型測驗：(1)聽力測驗 (2)閱讀測驗 (3)寫作測驗 (4)口說測驗

臺灣法國文化協會台北中心與高雄中心每年皆會舉辦數場法語鑑定考試。

報名截止日期為每場考試前八週，詳細內容、報名期限及辦法等都會公布在協會網站上。

考生可自由選擇所要報考的級數。各級別的法語鑑定文憑為各自獨立的文憑，所以報考者可依自己的程度報考。(舉例來說，若要報考 B1 級數，毋需先通過 A1 或 A2 級數)。且同一梯次測驗(若測驗時間無衝突)，考生可同時報考不同級數之測驗；若報考之測驗級數皆通過，將會拿到各別之鑑定文憑。

※法語檢定測驗日期，請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。

參考網址：<http://www.alliancefrancaise.org.tw/%E6%B3%95%E8%AA%9E%E6%AA%A2%E6%B8%AC/delf-dalf-%E4%BB%8B%E7%B4%B9/>

六、德語考試 Goethe-Institute

(一) 歌德 A1 級德語檢定考試 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

歌德 A1 級德語檢定考試證明您具備簡易德語能力，相當「歐語能力評量共同參考標準」所制定六級檢定考試中之第一級（A1）。為達到此一程度，考生不限學習教材或是否上過語文班，應約上過 80 至 200 堂德文課〔每堂課 45 分鐘〕。

考試內容包括：

1. 筆試（65 分鐘；限用黑色墨水筆，不得使用鉛筆。）
聆聽日常對話、私人的電話留言、公共廣播通告，並回答與現實近似的問題。
閱讀筆記、小廣告、指示牌、告示等，並回答問題。
填寫簡單的表格，並對一項日常狀況，寫一封短短的私函或 E-mail。
2. 口試（小組應試，最多四人，計時 15 分鐘）
小組中每人自我介紹。然後提問和回答日常生活的問題，向小組中的一位提出請託並答覆請託。

(二) 歌德 B1 級檢定考試 Goethe-Zertifikat B1

B1 級德語檢定考試 Zertifikat Deutsch 為「歐語能力評量共同參考標準」制定的 6 級檢定考試中之 B1 級德文的檢定考試，是由德國、瑞士、奧地利共同研發的德文檢定考試。若通過檢定考試，考生可證明自己的日常德語文法基礎紮實，能在日常生活重要場合，無論聽說讀寫都應對自如。

B1 級德語檢定考試是國際知名的檢定考試，是德國政府指定申請德國國籍，得據以證明德語程度的檢定考試。在臺灣，通過 B1 級德語檢定考試是申請教育部「公費留學德語系國家獎學金」、「臺德交換獎學金」、「藝術與設計菁英培訓計畫」等獎學金的條件之一。考生不限學習教材或是否上過語文班，建議應約上過 400 至 600 堂密集德文課。

※歌德檢定考試約每 1 至 2 月舉辦一次，實際測驗日期請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。參考網址：<http://www.goethe.de/ins/cn/cn/tai/lrn/prf/tdt.html>

七、TOPIK 韓國語言能力測驗

測驗目的

1. 為母語非韓國語之韓語學習者、韓國僑民、外國人提供學習方向；並祈達到普及韓語之效。
2. 測試和評量韓國語使用能力，並以此為留學韓國或就業的依據。

測驗級數及測驗費

測驗級數：TOPIK I、TOPIK II

依據測驗成績又可分為六等級(1~6 級)

3. TOPIK I 為舊制初級、TOPIK II 為舊制中、高級
4. TOPIK I 測驗費 NT\$1,100、TOPIK II 測驗費 NT\$1,400

測驗級數	TOPIK I		TOPIK II			
成績等及	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
判定	80 分以上	140 分以上	120 分以上	150 分以上	190 分以上	230 分以上

※ TOPIK 韓國語言能力測驗日期，請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。

參考網址：<https://www.topik.go.kr/TWMAIN/TWMAIN0010.do>

<https://www.topik.com.tw/>

一、綜合設計類：

1. 德國紅點設計獎 Red Dot Design Award	第一等
2. 美國傑出工業設計獎 Industrial Design Excellence Award (IDEA)	第一等
3. 德國 iF 設計獎 iF Design Award	第一等
4. 英國設計與藝術指導協會新血獎 D&AD New Blood Awards	第一等
5. 奧地利國際電子藝術競賽 Prix Ars Electronica-International Competition for CyberArts	第一等
6. 英國倫敦國際獎 London International Awards	第一等
7. 日本 G-Mark 設計獎 Good Design Award (G-Mark)	第一等
8. Adobe 卓越設計大獎 Adobe Design Achievement Awards (ADAA)	第一等
9. 紐約藝術指導協會年度獎 New York Art Directors Club Annual Awards	第一等

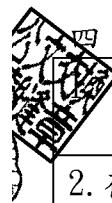
二、產品設計類：

1. 德國 iF 獎 iF Design Award	第一等
2. 德國百靈國際設計大賽 BraunPrize International Design Award	第一等
3. 德國紅點設計獎 Red Dot Design Award	第一等

三、視覺傳達設計類：

1. 波蘭華沙國際海報雙年展 International Poster Biennale in Warsaw	第一等
2. 捷克布魯諾國際平面設計雙年展 International Biennale of Graphic Design in Brno	第一等
3. 日本富山國際海報三年展 International Poster Triennial in Toyama	第一等
4. 法國蕭蒙國際海報節國際競賽學生展 Students, All to Chaumont' Poster Competition	第一等

5. 義大利波隆那國際兒童書插畫展 Bologna Children' s Book Fair - Illustrators Exhibition	第一等
6. 墨西哥國際海報雙年展 The International Biennale of Poster in Mexico	第一等
7. 英國設計與藝術指導協會新血獎 D&AD New Blood Awards	第一等
8. 英國倫敦國際獎 London International Awards	第一等
9. 美國傳達藝術年度獎 Communication Arts	第一等
10. 芬蘭拉赫第國際海報三年展 Lahti International Poster Triennial	第一等
11. 美國 One Show 獎 The One Show	第一等
12. 東京 TOKYO TDC 字體設計競賽 Tokyo Type Directors Club Annual Award	第一等
13. NY TDC 紐約字體設計競賽 NY TDC Awards	第一等
14. 莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎 Golden Bee Global Biennale of Graphic Design	第一等



四、數位動畫類：

1. 美國 ACM SIGGRAPH 電腦動畫展 ACM SIGGRAPH Computer Animation Festival	第一等
2. 荷蘭 Kaboom 動畫影展 Kaboom Animation Festival	第一等
3. 加拿大渥太華國際動畫影展 Ottawa International Animation Festival	第一等
4. 法國安錫動畫影展 Annecy International Animation Film Festival	第一等
5. 德國柏林短片影展 International Short Film Festival Berlin	第一等
6. 奧地利國際電子藝術競賽 Prix Ars Electronica-International Competition for CyberArts	第一等
7. 英國倫敦國際獎 London International Awards	第一等
8. 韓國富川國際學生動畫影展 Bucheon International Student Animation Festival	第二等
9. 日本廣島國際動畫影展 International Animation Festival Hiroshima	第二等

10. 澳洲墨爾本國際動畫影展 Melbourne International Animation Festival	第二等
---	-----

五、工藝設計類：

1. 德國 TALENTE 國際競賽展 TALENTE	第一等
2. 日本美濃國際陶藝競賽(三年展) International Ceramics Competition MINO, Japan	第一等
3. 義大利法恩扎當代國際陶藝獎(雙年展) International Competition of Contemporary Ceramic Art	第一等
4. 韓國國際陶瓷雙年展 Korean International Ceramic Biennale (KICB)	第一等
5. 日本伊丹國際當代首飾(工藝)展 ITAMI International Contemporary Jewellery(Craft) Exhibition	第一等
6. 德國杜塞道夫「Friedrich Becker」獎 Friedrich Becker Preis Düsseldorf	第二等
7. 韓國清州國際工藝大賽(雙年展) Cheongju Craft Biennale	第二等

六、建築與景觀設計類

1. IFLA 學生國際景觀建築設計競賽 IFLA STUDENT LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN COMPETITION	第一等
2. Archiprix 全球建築畢業設計大獎(雙年獎) Archiprix International	第一等
3. OISTAT 國際劇場建築競賽 OISTAT Theatre Architecture Competition	第二等
4. RIBA 英國皇家建築師學會會長獎 RIBA Presidents Medals Students Award	第一等
5. ISARCH 建築學生獎 ISARCH Awards for Architecture Students	第二等
6. eVolo 摩天大樓設計競賽 eVolo Skyscraper Competition	第二等
7. 日本中央玻璃國際建築設計競賽 Central Glass International Architectural Design Competition	第二等
8. IFLA 亞太區學生國際景觀建築設計競賽 IFLA APR Student Design Competition	第二等
9. 美國建築大師獎 The Architecture Master Prize (AMP)	第三等
10. VELUX 國際建築設計競賽	第二等

International VELUX Award	
11. IIDA 國際室內設計協會學生設計競賽 IIDA Student Design Competition	第三等

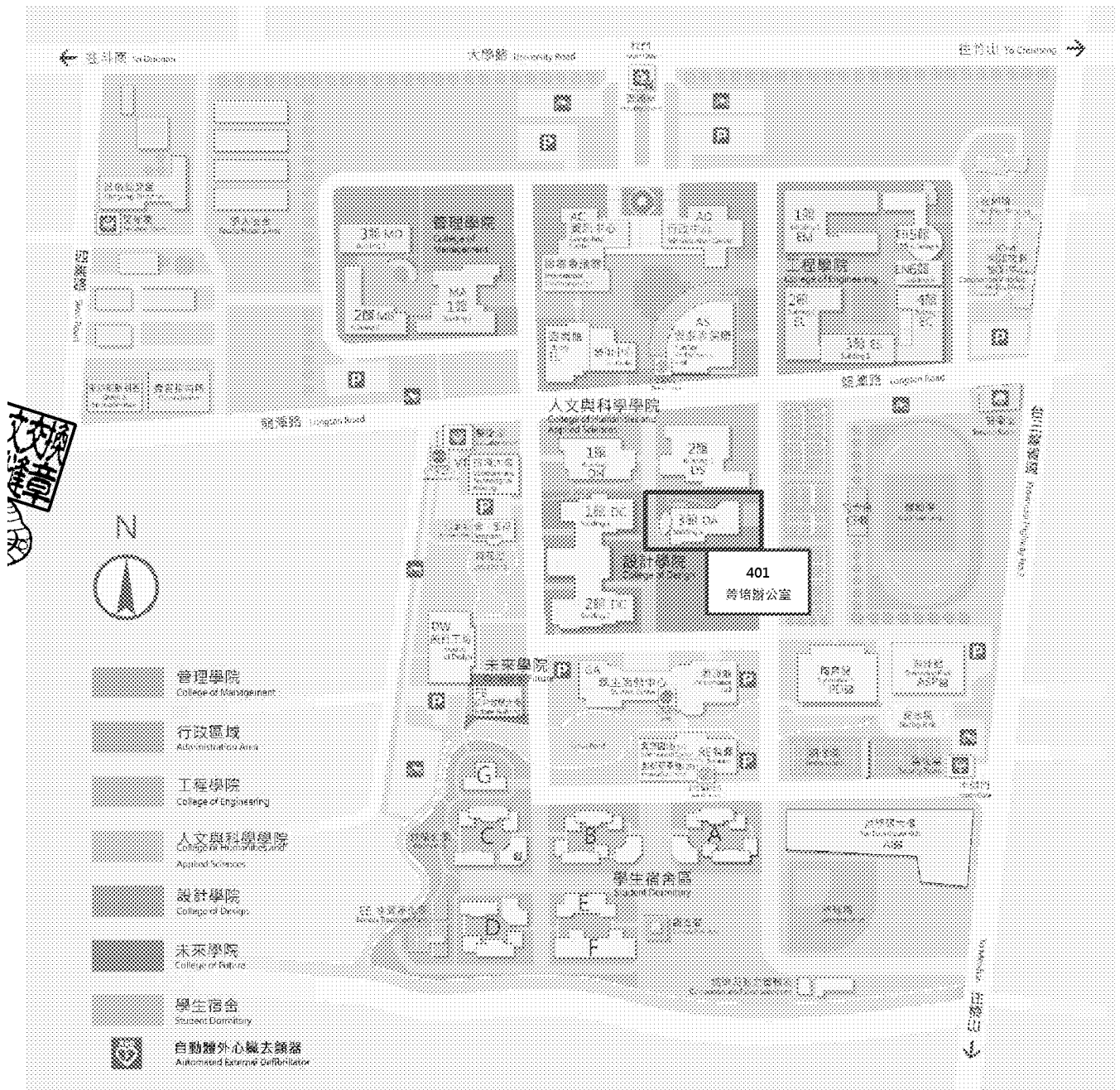
七、時尚設計類

1. 法國路易威登精品大賽 LVMH Prize	第一等
2. 世界可穿著藝術大賽 World of WearableArt Awards Show (WOW)	第二等
3. 義大利國際人才支持獎 International Talent Support (ITS)	第一等
4. iD 國際新銳設計師獎 iD International Emerging Designer Awards	第一等
5. 洛茲國際織錦三年展 International Triennial of Tapestry (ITT)	第一等
6. 名古屋時裝大賽 Nagoya Fashion Contest	第二等

【最近修訂】民國 112 年 02 月 03 日臺教高（一）字第 1122200110A 號



附錄三 國立雲林科技大學位置圖



自行駕車

●南下：

- 國道一號 (中山高) → 斗南交流道 → 台一線 238K → 斗六 → 本校 (約 8 分鐘)
- 國道一號 (中山高) → 西螺交流道 → 蔴桐 → 斗六 → 本校 (約 20 分鐘)
- 國道三號 (南二高) → 斗六交流道 → 斗六 → 本校 (約 10 分鐘)

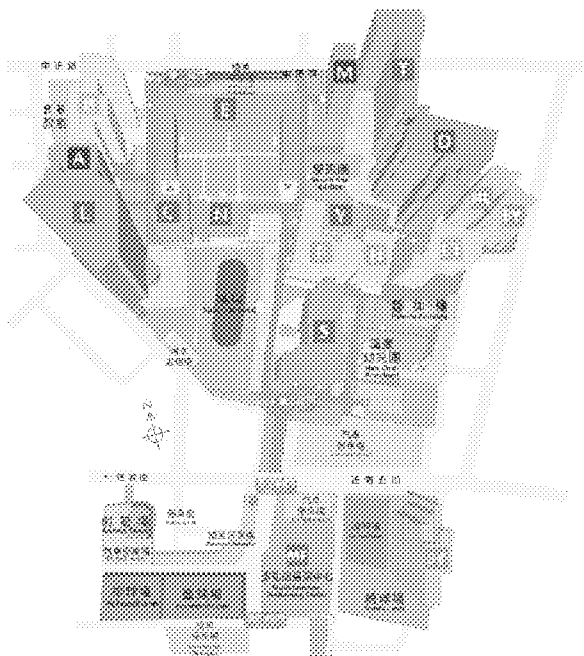
●北上：

- 國道一號 (中山高) → 斗南交流道 → 台一線 238K → 斗六 → 本校 (約 8 分鐘)
- 國道一號 (中山高) → 大林交流道 → 斗南 → 台一線 238K → 斗六 → 本校 (約 25 分鐘)
- 國道三號 (南二高) → 古坑交流道 → 東西向快速道路 78 → 斗六 → 本校 (約 8 分鐘)

搭乘大眾交通工具

本校備有校車、雲林高鐵、斗火車站至本校之各種客運、接駁車，詳細資訊請至下列網址查詢：
<https://www.yuntech.edu.tw/index.php/2019-04-02-07-04-39/2/2019-04-02-07-27-53>

附錄四 台南應用科技大學位置圖



台鐵台南站：可搭 5 號、21 號公車至鹽行站，由中正路步行至本校約 3 分鐘，或搭計程車到校(約 20 分鐘)。
台鐵永康站：可搭 20 號公車至台南應用科大站，或搭計程車到校(約 10 分鐘)。

高鐵(台南站)

- (1) 可搭高鐵快捷公車(奇美線)至鹽行站，由中正路步行至本校約 3 分鐘，或搭計程車至本校。
- (2) 可搭台鐵沙崙站區間車至台南火車站，再轉搭 5 號、21 號公車至鹽行站，由中正路步行至本校約 3 分鐘。
- (3) 可搭台鐵沙崙站區間車至永康火車站，再轉搭 20 號公車至台南應用科大站。

客運

南下可搭統聯、和欣及國光客運往台南，至鹽行站下車，由中正路步行至本校約 3 分鐘。

高速公路

※北上車輛

- (1) 國道 1(中山高)北上 320 公里處由永康交流道下，往台南市區方向約 1 公里即達本校。
- (2) 國道 3(南二高)→新化系統轉接國道 8→台南系統轉接國道 1(中山高)往台南方向，於南下 318 公里處由永康交流道下，轉往台南市區方向約 1 公里即達本校。
- (3) 國道 3(南二高)→關廟系統下→轉機場聯絡快速道路(86 號)西行→接中山高速公路往北上→永康交流道下往台南市區方向約 1 公里即達本校。


※南上車輛

- (1) 國道 1(中山高)南下 318 公里處由永康交流道下，右轉往台南市區方向約 1 公里即達本校。
- (2) 國道 3(南二高)→新化系統轉接國道 8→台南系統轉接國道 1(中山高)往台南方向，於南下 318 公里處由永康交流道下，右轉往台南市區方向約 1 公里即達本校。



附錄五 國立成功大學位置圖



 行開車 國道路線)	<p>【南下】 沿國道一號南下 → 下永康交流道右轉 → 沿中正北路、中正南路（南向）往台南市區直行 → 中華路左轉 → 沿中華東路前進 → 於小東路口右轉，直走即可抵達本校。 ※自國道三號南下者，轉國道8號（西向），可接國道一號（南向）</p>
	<p>【北上】 沿國道一號北上 → 下仁德交流道左轉 → 沿東門路（西向）往台南市區直走 → 遇林森路或長榮路右轉（北向），即可抵達本校。 ※自國道三號北上者，轉86號快速道路（西向），可接國道一號（北向）</p>
搭乘火車	於台南站下車後，自後站出口（大學路），大學路左側即為本校光復校區。
搭乘高鐵	搭乘台灣高鐵抵台南站者，可至高鐵台南站二樓轉乘通廊或一樓大廳1號出口前往台鐵沙崙站搭乘台鐵區間車前往台南火車站，約30分鐘一班車，20分鐘可到達台南火車站；成功大學自台南火車站 後站出口 步行即可到達。

113 年度教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」-「數位動畫組」報名表

申請身分別		<input type="checkbox"/> 學校推薦 <input type="checkbox"/> 個人申請 <input type="checkbox"/> 金點新秀設計獎年度最佳設計獎者		申請編號		*本欄由主辦單位填寫，請勿填寫、畫記*							
姓名 / 中文				身分證字號									
姓名 / 英文 (同護照格式)													
性別		<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		出生日期		西元		年		月		日	
電子郵件				(務必填寫正確，以後會常以此 E-mail 聯絡)									
通訊地址				□□□□-□□ (3+2 郵遞區號務必填寫) 請提供可收掛號信之地址，以利文件寄送；請勿填宿舍、租屋處等易變動之地址。									
聯絡電話		手機：		通訊地址 市內電話		住所：							
學歷	就讀校	(請填完整學校名稱)		推薦教授		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)							
	系所	(請填完整系所名稱)		推薦教授 聯絡電話		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)							
	年級	碩士班/大學部_____年級		推薦教授 電子郵件		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)							
在學身分備註				<input type="checkbox"/> 大四確定延畢 <input type="checkbox"/> 碩二確定延畢 <input type="checkbox"/> 已應屆考取研究所 (請檢附錄取文件影本)									
家長或監護人				手機號碼									
兵役情形				<input type="checkbox"/> 已服役 <input type="checkbox"/> 免服役 <input type="checkbox"/> 尚未服役 <input type="checkbox"/> 現役軍人									
須檢附資料	學校推薦		個人申請		金點新秀設計獎年度最佳設計獎者								
	<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 大學(含)以上在學成績單 <input type="checkbox"/> 學校系所推薦公文 <input type="checkbox"/> 老師推薦函 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 大學(含)以上在校成績單 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本								
	<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 大學(含)以上在學成績單 <input type="checkbox"/> 學校系所推薦公文 <input type="checkbox"/> 老師推薦函 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 大學(含)以上在校成績單 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本								
確認資料 申請人簽名		本人已詳閱甄選簡章中之各項規定以及個人資料保護聲明。經由通訊報名之各項資料均為本人親自填報，並確實繳交上述資料，若有不實，願負法律責任並同意被取消錄取資格。 親筆簽名： 填寫日期： 年 月 日						請黏貼近三個月內 二吋半身脫帽照片 ※請勿使用生活照、不得戴有色鏡片之眼鏡					

<報名表請雙面列印>

-----身分證正面影本黏貼處-----

-----身分證反面影本黏貼處-----



-----學生證正面影本黏貼處-----

-----學生證反面影本黏貼處-----

個人資料保護聲明

國立雲林科技大學菁培計畫總辦公室為「教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫-數位動畫組」之承辦單位（以下稱本組承辦單位），依據個人資料保護法（以下稱個資法）規定，為保護您的個人資料，於下列事由與目的範圍內，說明本組承辦單位個人資料蒐集、處理及利用告知事項。當您完成報名時，表示您同意以下內容：

1. 個人資料蒐集、處理及利用之目的：本組承辦單位基於教育部菁培獎學金甄選作業以及執行本計畫業務之必要範圍內蒐集、處理及利用您的個人資料。您同意本組承辦單位以您所提供的個人資料確認您的身份、與您進行連絡、提供您本計畫之相關資訊及業務處理，包括後續通知等用途。
2. 個人資料之類別：
 - (1) 基本資料：辨識個人者、政府資料中之辨識者、個人描述等個人資料類別，內容包括姓名、國民身分證統一編號或其他身分證件號碼、出生年月日、性別、電話、電子郵件聯絡資訊等。
 - (2) 專業技能資料：學校紀錄、資格或技術等個人資料類別。
3. 您同意本組承辦單位於本計畫執行期間利用您個人資料的期間、地區、對象及方式：
 - (1) 期間：除法令另有規定辦理之個人資料保存期限外，以完成上開蒐集、處理及利用之目的或本組承辦單位執行業務所必須之期間為利用期間。
 - (2) 地區：台灣地區（包括澎湖、金門及馬祖等地區）或其他為完成上開蒐集、處理及利用之目的所必須之地區。
 - (3) 對象：本組承辦單位及本計畫相關人員。方式：以電話、電子郵件、紙本或其他合於當時科技之適當方式作個人資料之利用。
4. 您的個人資料蒐集之目的消失或期限屆滿時，您同意本計畫得繼續保存、處理或利用您的個人資料。除本組承辦單位於專業執行期間因執行職務或業務所必須或為遵循其他法令之規定者外，您可於專業期間隨時向本組承辦單位請求刪除、停止處理或利用您的個人資料。
5. 您得選擇是否提供相關個人資料予本案蒐集、處理及利用，惟您若選擇不提供，或只提供部份/不完全/不真實/不正確個人資料予本組承辦單位，或提供後向本組承辦單位請求刪除部分或全部個人資料，或您所提供的個人資料，經檢舉或發現不足以確認您的身分真實性或其他個人資料冒用、盜用等情形時，導致本組承辦單位無法進行必要之審核及處理，可能導致無法順利參與本計畫甄選，亦有可能造成緊急事件無法聯繫及甄選結果無法送達等事項，並影響您後續相關權益。本組承辦單位有權停止提供對您的業務處理，若有不便之處尚請見諒。
6. 為維護您的權益，本組承辦單位將採用適當之安全維護措施以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

113 年度教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」-「視覺傳達設計組」報名表

申請身分別		<input type="checkbox"/> 學校推薦 <input type="checkbox"/> 個人申請 <input type="checkbox"/> 金點新秀設計獎年度最佳設計獎者		申請編號		*本欄由主辦單位填寫，請勿填寫、畫記*							
姓名 / 中文				身分證字號									
姓名 / 英文 (同護照格式)													
性別		<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		出生日期		西元		年		月		日	
電子郵件				(務必填寫正確，以後會常以此 E-mail 聯絡)									
通訊地址				□□□□-□□ (3+2 郵遞區號務必填寫) 請提供可收掛號信之地址，以利文件寄送；請勿填宿舍、租屋處等易變動之地址。									
聯絡電話		手機：		通訊地址 市內電話		住所：							
學歷	就讀校	(請填完整學校名稱)		推薦教授		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)							
	系所	(請填完整系所名稱)		推薦教授 聯絡電話		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)							
	年級	碩士班/大學部_____年級		推薦教授 電子郵件		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)							
在學身分備註				<input type="checkbox"/> 大四確定延畢 <input type="checkbox"/> 碩二確定延畢 <input type="checkbox"/> 已應屆考取研究所 (請檢附錄取文件影本)									
家長或監護人				手機號碼									
兵役情形				<input type="checkbox"/> 已服役 <input type="checkbox"/> 免服役 <input type="checkbox"/> 尚未服役 <input type="checkbox"/> 現役軍人									
須檢附資料		學校推薦		個人申請		金點新秀設計獎年度最佳設計獎者							
		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 大學(含)以上在學成績單 <input type="checkbox"/> 學校系所推薦公文 <input type="checkbox"/> 老師推薦函 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 大學(含)以上在校成績單 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本							
確認資料 申請人簽名		本人已詳閱甄選簡章中之各項規定以及個人資料保護聲明。經由通訊報名之各項資料均為本人親自填報，並確實繳交上述資料，若有不實，願負法律責任並同意被取消錄取資格。 親筆簽名：						請黏貼近三個月內 二吋半身脫帽照片 ※請勿使用生活照、不得戴有色鏡片之眼鏡					
		填寫日期：		年		月		日					

<報名表請雙面列印>

-----身分證正面影本黏貼處-----

-----身分證反面影本黏貼處-----

-----學生證正面影本黏貼處-----

-----學生證反面影本黏貼處-----

個人資料保護聲明

國立雲林科技大學菁培計畫總辦公室為「教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫-視覺傳達設計組」之承辦單位（以下稱本組承辦單位），依據個人資料保護法（以下稱個資法）規定，為保護您的個人資料，於下列事由與目的範圍內，說明本組承辦單位個人資料蒐集、處理及利用告知事項。當您完成報名時，表示您同意以下內容：

1. 個人資料蒐集、處理及利用之目的：本組承辦單位基於教育部菁培獎學金甄選作業以及執行本計畫業務之必要範圍內蒐集、處理及利用您的個人資料。您同意本組承辦單位以您所提供的個人資料確認您的身份、與您進行連絡、提供您本計畫之相關資訊及業務處理，包括後續通知等用途。
2. 個人資料之類別：
 - (1) 基本資料：辨識個人者、政府資料中之辨識者、個人描述等個人資料類別，內容包括姓名、國民身分證統一編號或其他身分證件號碼、出生年月日、性別、電話、電子郵件聯絡資訊等。
 - (2) 專業技能資料：學校紀錄、資格或技術等個人資料類別。
3. 您同意本組承辦單位於本計畫執行期間利用您個人資料的期間、地區、對象及方式：
 - (1) 期間：除法令另有規定辦理之個人資料保存期限外，以完成上開蒐集、處理及利用之目的或本組承辦單位執行業務所必須之期間為利用期間。
 - (2) 地區：台灣地區（包括澎湖、金門及馬祖等地區）或其他為完成上開蒐集、處理及利用之目的所必須之地區。
 - (3) 對象：本組承辦單位及本計畫相關人員。方式：以電話、電子郵件、紙本或其他合於當時科技之適當方式作個人資料之利用。
4. 您的個人資料蒐集之目的消失或期限屆滿時，您同意本計畫得繼續保存、處理或利用您的個人資料。除本組承辦單位於專業執行期間因執行職務或業務所必須或為遵循其他法令之規定者外，您可於專業期間隨時向本組承辦單位請求刪除、停止處理或利用您的個人資料。
5. 您得選擇是否提供相關個人資料予本案蒐集、處理及利用，惟您若選擇不提供，或只提供部份/不完全/不真實/不正確個人資料予本組承辦單位，或提供後向本組承辦單位請求刪除部分或全部個人資料，或您所提供的個人資料，經檢舉或發現不足以確認您的身分真實性或其他個人資料冒用、盜用等情形時，導致本組承辦單位無法進行必要之審核及處理，可能導致無法順利參與本計畫甄選，亦有可能造成緊急事件無法聯繫及甄選結果無法送達等事項，並影響您後續相關權益。本組承辦單位有權停止提供對您的業務處理，若有不便之處尚請見諒。
6. 為維護您的權益，本組承辦單位將採用適當之安全維護措施以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

113 年度教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」-『產品設計組』報名表

申請身分別		<input type="checkbox"/> 學校推薦 <input type="checkbox"/> 個人申請 <input type="checkbox"/> 金點新秀設計獎年度最佳設計獎者		申請編號		*本欄由主辦單位填寫，請勿填寫、畫記*							
姓名 / 中文				身分證字號									
姓名 / 英文 (同護照格式)													
性別		<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		出生日期		西元		年		月		日	
電子郵件				(務必填寫正確，以後會常以此 E-mail 聯絡)									
通訊地址				□□□□-□□ (3+2 郵遞區號務必填寫) 請提供可收掛號信之地址，以利文件寄送；請勿填宿舍、租屋處等易變動之地址。									
聯絡電話		手機：		通訊地址 市內電話		住所：							
學歷	就讀校	(請填完整學校名稱)		推薦教授		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)							
	系所	(請填完整系所名稱)		推薦教授 聯絡電話		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)							
	年級	碩士班/大學部_____年級		推薦教授 電子郵件		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)							
在學身分備註				<input type="checkbox"/> 大四確定延畢 <input type="checkbox"/> 碩二確定延畢 <input type="checkbox"/> 已應屆考取研究所 (請檢附錄取文件影本)									
家長或監護人				手機號碼									
兵役情形				<input type="checkbox"/> 已服役 <input type="checkbox"/> 免服役 <input type="checkbox"/> 尚未服役 <input type="checkbox"/> 現役軍人									
須檢附資料		學校推薦		個人申請		金點新秀設計獎年度最佳設計獎者							
		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 大學(含)以上在學成績單 <input type="checkbox"/> 學校系所推薦公文 <input type="checkbox"/> 老師推薦函 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 大學(含)以上在校成績單 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本							
確認資料 申請人簽名		本人已詳閱甄選簡章中之各項規定以及個人資料保護聲明。經由通訊報名之各項資料均為本人親自填報，並確實繳交上述資料，若有不實，願負法律責任並同意被取消錄取資格。 親筆簽名： 填寫日期： 年 月 日						請黏貼近三個月內 二吋半身脫帽照片 ※請勿使用生活照、 不得戴有色鏡片之眼鏡					

<報名表請雙面列印>

-----身分證正面影本黏貼處-----

-----身分證反面影本黏貼處-----

-----學生證正面影本黏貼處-----

-----學生證反面影本黏貼處-----



個人資料保護聲明

國立成功大學工業設計系為「教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫-產品設計組」之承辦單位（以下稱本組承辦單位），依據個人資料保護法（以下稱個資法）規定，為保護您的個人資料，於下列事由與目的範圍內，說明本組承辦單位個人資料蒐集、處理及利用告知事項。當您完成報名時，表示您同意以下內容：

1. 個人資料蒐集、處理及利用之目的：本組承辦單位基於教育部菁英獎學金甄選作業以及執行本計畫業務之必要範圍內蒐集、處理及利用您的個人資料。您同意本組承辦單位以您所提供的個人資料確認您的身份、與您進行連絡、提供您本計畫之相關資訊及業務處理，包括後續通知等用途。
2. 個人資料之類別：
 - (1) 基本資料：辨識個人者、政府資料中之辨識者、個人描述等個人資料類別，內容包括姓名、國民身分證統一編號或其他身分證件號碼、出生年月日、性別、電話、電子郵件聯絡資訊等。
 - (2) 專業技能資料：學校紀錄、資格或技術等個人資料類別。
3. 您同意本組承辦單位於本計畫執行期間利用您個人資料的期間、地區、對象及方式：
 - (1) 期間：除法令另有規定辦理之個人資料保存期限外，以完成上開蒐集、處理及利用之目的或本組承辦單位執行業務所必須之期間為利用期間。
 - (2) 地區：台灣地區（包括澎湖、金門及馬祖等地區）或其他為完成上開蒐集、處理及利用之目的所必須之地區。
 - (3) 對象：本組承辦單位及本計畫相關人員。方式：以電話、電子郵件、紙本或其他合於當時科技之適當方式作個人資料之利用。
4. 您的個人資料蒐集之目的消失或期限屆滿時，您同意本計畫得繼續保存、處理或利用您的個人資料。除本組承辦單位於專業執行期間因執行職務或業務所必須或為遵循其他法令之規定者外，您可於專業期間隨時向本組承辦單位請求刪除、停止處理或利用您的個人資料。
5. 您得選擇是否提供相關個人資料予本案蒐集、處理及利用，惟您若選擇不提供，或只提供部份/不完全/不真實/不正確個人資料予本組承辦單位，或提供後向本組承辦單位請求刪除部分或全部個人資料，或您所提供的個人資料，經檢舉或發現不足以確認您的身分真實性或其他個人資料冒用、盜用等情形時，導致本組承辦單位無法進行必要之審核及處理，可能導致無法順利參與本計畫甄選，亦有可能造成緊急事件無法聯繫及甄選結果無法送達等事項，並影響您後續相關權益。本組承辦單位有權停止提供對您的業務處理，若有不便之處尚請見諒。
6. 為維護您的權益，本組承辦單位將採用適當之安全維護措施以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。



113 年度教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」-『建築與景觀設計組』報名表

申請身分別		<input type="checkbox"/> 學校推薦 <input type="checkbox"/> 個人申請 <input type="checkbox"/> 金點新秀設計獎年度最佳設計獎者		申請編號		*本欄由主辦單位填寫，請勿填寫、畫記*							
姓名 / 中文				身分證字號									
姓名 / 英文 (同護照格式)													
性別		<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		出生日期		西元		年		月		日	
電子郵件				(務必填寫正確，以後會常以此 E-mail 聯絡)									
通訊地址				□□□□-□□ (3+2 郵遞區號務必填寫) 請提供可收掛號信之地址，以利文件寄送；請勿填宿舍、租屋處等易變動之地址。									
聯絡電話		手機：		通訊地址 市內電話		住所：							
學歷	就讀校	(請填完整學校名稱)		推薦教授		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)							
	系所	(請填完整系所名稱)		推薦教授 聯絡電話		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)							
	年級	碩士班/大學部_____年級		推薦教授 電子郵件		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)							
在學身分備註				<input type="checkbox"/> 大四確定延畢 <input type="checkbox"/> 碩二確定延畢 <input type="checkbox"/> 已應屆考取研究所 (請檢附錄取文件影本)									
家長或監護人				手機號碼									
兵役情形				<input type="checkbox"/> 已服役 <input type="checkbox"/> 免服役 <input type="checkbox"/> 尚未服役 <input type="checkbox"/> 現役軍人									
須檢附資料		學校推薦		個人申請		金點新秀設計獎年度最佳設計獎者							
		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 大學(含)以上在學成績單 <input type="checkbox"/> 學校系所推薦公文 <input type="checkbox"/> 老師推薦函 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 大學(含)以上在校成績單 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本							
確認資料 申請人簽名		本人已詳閱甄選簡章中之各項規定以及個人資料保護聲明。經由通訊報名之各項資料均為本人親自填報，並確實繳交上述資料，若有不實，願負法律責任並同意被取消錄取資格。 親筆簽名： 填寫日期： 年 月 日						請黏貼近三個月內 二吋半身脫帽照片 ※請勿使用生活照、 不得戴有色鏡片之眼鏡					

<報名表請雙面列印>

-----身分證正面影本黏貼處-----

-----身分證反面影本黏貼處-----

-----學生證正面影本黏貼處-----

-----學生證反面影本黏貼處-----

個人資料保護聲明



國立成功大學建築學系為「教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫-建築與景觀設計組」之承辦單位（以下稱本組承辦單位），依據個人資料保護法（以下稱個資法）規定，為保護您的個人資料，於下列事由與目的範圍內，說明本組承辦單位個人資料蒐集、處理及利用告知事項。當您完成報名時，表示您同意以下內容：

個人資料蒐集、處理及利用之目的：本組承辦單位基於教育部菁英獎學金甄選作業以及執行本計畫業務之必要範圍內蒐集、處理及利用您的個人資料。您同意本組承辦單位以您所提供的個人資料確認您的身份、與您進行連絡、提供您本計畫之相關資訊及業務處理，包括後續通知等用途。

個人資料之類別：

- (1) 基本資料：辨識個人者、政府資料中之辨識者、個人描述等個人資料類別，內容包括姓名、國民身分證統一編號或其他身分證件號碼、出生年月日、性別、電話、電子郵件聯絡資訊等。
- (2) 專業技能資料：學校紀錄、資格或技術等個人資料類別。
3. 您同意本組承辦單位於本計畫執行期間利用您個人資料的期間、地區、對象及方式：
 - (1) 期間：除法令另有規定辦理之個人資料保存期限外，以完成上開蒐集、處理及利用之目的或本組承辦單位執行業務所必須之期間為利用期間。
 - (2) 地區：台灣地區（包括澎湖、金門及馬祖等地區）或其他為完成上開蒐集、處理及利用之目的所必須之地區。
 - (3) 對象：本組承辦單位及本計畫相關人員。方式：以電話、電子郵件、紙本或其他合於當時科技之適當方式作個人資料之利用。
4. 您的個人資料蒐集之目的消失或期限屆滿時，您同意本計畫得繼續保存、處理或利用您的個人資料。除本組承辦單位於專業執行期間因執行職務或業務所必須或為遵循其他法令之規定者外，您可於專業期間隨時向本組承辦單位請求刪除、停止處理或利用您的個人資料。
5. 您得選擇是否提供相關個人資料予本案蒐集、處理及利用，惟您若選擇不提供，或只提供部份/不完全/不真實/不正確個人資料予本組承辦單位，或提供後向本組承辦單位請求刪除部分或全部個人資料，或您所提供的個人資料，經檢舉或發現不足以確認您的身分真實性或其他個人資料冒用、盜用等情形時，導致本組承辦單位無法進行必要之審核及處理，可能導致無法順利參與本計畫甄選，亦有可能造成緊急事件無法聯繫及甄選結果無法送達等事項，並影響您後續相關權益。本組承辦單位有權停止提供對您的業務處理，若有不便之處尚請見諒。
6. 為維護您的權益，本組承辦單位將採用適當之安全維護措施以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

113 年度教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」-『時尚設計組』報名表

申請身分別		<input type="checkbox"/> 學校推薦 <input type="checkbox"/> 個人申請 <input type="checkbox"/> 金點新秀設計獎年度最佳設計獎者		申請編號		*本欄由主辦單位填寫，請勿填寫、畫記*							
姓名 / 中文				身分證字號									
姓名 / 英文 (同護照格式)													
性別		<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		出生日期		西元		年		月		日	
電子郵件				(務必填寫正確，以後會常以此 E-mail 聯絡)									
通訊地址				□□□□-□□ (3+2 郵遞區號務必填寫) 請提供可收掛號信之地址，以利文件寄送；請勿填宿舍、租屋處等易變動之地址。									
聯絡電話		手機：		通訊地址 市內電話		住所：							
學歷	就讀校		(請填完整學校名稱)		推薦教授		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)						
	系所		(請填完整系所名稱)		推薦教授 聯絡電話		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)						
	年級		碩士班/大學部_____年級		推薦教授 電子郵件		(如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位)						
在學身分備註				<input type="checkbox"/> 大四確定延畢 <input type="checkbox"/> 碩二確定延畢 <input type="checkbox"/> 已應屆考取研究所 (請檢附錄取文件影本)									
家長或監護人				手機號碼									
兵役情形				<input type="checkbox"/> 已服役 <input type="checkbox"/> 免服役 <input type="checkbox"/> 尚未服役 <input type="checkbox"/> 現役軍人									
須檢附資料		學校推薦		個人申請		金點新秀設計獎年度最佳設計獎者							
		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 大學(含)以上在學成績單 <input type="checkbox"/> 學校系所推薦公文 <input type="checkbox"/> 老師推薦函 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 大學(含)以上在校成績單 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本		<input type="checkbox"/> 填寫本報名表 <input type="checkbox"/> 作品集 <input type="checkbox"/> 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單) <input type="checkbox"/> 其他有助於審查之證明文件與資料影本							
確認資料 申請人簽名		本人已詳閱甄選簡章中之各項規定以及個人資料保護聲明。經由通訊報名之各項資料均為本人親自填報，並確實繳交上述資料，若有不實，願負法律責任並同意被取消錄取資格。 親筆簽名：						請黏貼近三個月內 二吋半身脫帽照片 ※請勿使用生活照、 不得戴有色鏡片之眼鏡					
		填寫日期：		年		月		日					

<報名表請雙面列印>

身分證正面影本黏貼處

身分證反面影本黏貼處

學生證正面影本黏貼處

學生證反面影本黏貼處

個人資料保護聲明

國立雲林科技大學菁培計畫總辦公室為「教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫-時尚設計組」之承辦單位（以下稱本組承辦單位），依據個人資料保護法（以下稱個資法）規定，為保護您的個人資料，於下列事由與目的範圍內，說明本組承辦單位個人資料蒐集、處理及利用告知事項。當您完成報名時，表示您同意以下內容：

1. 個人資料蒐集、處理及利用之目的：本組承辦單位基於教育部菁培獎學金甄選作業以及執行本計畫業務之必要範圍內蒐集、處理及利用您的個人資料。您同意本組承辦單位以您所提供的個人資料確認您的身份、與您進行連絡、提供您本計畫之相關資訊及業務處理，包括後續通知等用途。
2. 個人資料之類別：
 - (1) 基本資料：辨識個人者、政府資料中之辨識者、個人描述等個人資料類別，內容包括姓名、國民身分證統一編號或其他身分證件號碼、出生年月日、性別、電話、電子郵件聯絡資訊等。
 - (2) 專業技能資料：學校紀錄、資格或技術等個人資料類別。
3. 您同意本組承辦單位於本計畫執行期間利用您個人資料的期間、地區、對象及方式：
 - (1) 期間：除法令另有規定辦理之個人資料保存期限外，以完成上開蒐集、處理及利用之目的或本組承辦單位執行業務所必須之期間為利用期間。
 - (2) 地區：台灣地區（包括澎湖、金門及馬祖等地區）或其他為完成上開蒐集、處理及利用之目的所必須之地區。
 - (3) 對象：本組承辦單位及本計畫相關人員。方式：以電話、電子郵件、紙本或其他合於當時科技之適當方式作個人資料之利用。

您的個人資料蒐集之目的消失或期限屆滿時，您同意本計畫得繼續保存、處理或利用您的個人資料。除本組承辦單位於專案執行期間因執行職務或業務所必須或為遵循其他法令之規定者外，您可於專案期間隨時向本組承辦單位請求刪除、停止處理或利用您的個人資料。

您得選擇是否提供相關個人資料予本案蒐集、處理及利用，惟您若選擇不提供，或只提供部份/不完全/不真實/不正確個人資料予本組承辦單位，或提供後向本組承辦單位請求刪除部分或全部個人資料，或您所提供的個人資料，經審核或發現不足以確認您的身分真實性或其他個人資料冒用、盜用等情形時，導致本組承辦單位無法進行必要之審核及處理，可能導致無法順利參與本計畫甄選，亦有可能造成緊急事件無法聯繫及甄選結果無法送達等事項，並影響您後續相關權益。本組承辦單位有權停止提供對您的業務處理，若有不便之處尚請見諒。

6. 為維護您的權益，本組承辦單位將採用適當之安全維護措施以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

附表六 教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」- 老師推薦函

申請人姓名：_____；推薦人姓名：_____

一、申請人在下列項目表現：

評估項目	極佳 (前5%)	甚佳 (5%-10%)	佳 (10%-25%)	尚可 (25%-50%)	差 (50%以下)	資訊不足
自動自發的態度						
成熟與穩定度						
獨立工作能力						
共事能力						
表達能力						
領導能力						
邏輯分析能力						
專業知能						
創新能力						
研究潛能						
整體總評						

二、申請人的求學與工作態度：

積極主動 嚴謹小心 尚可 消極被動 無從判斷

三、依申請人的表現，具有之特殊研究能力，相關之優缺點，及未來發展潛力，請說明：

四、綜合上列評估，推薦對申請者申請計畫所持態度：

極力推薦 推薦 勉強推薦 不推薦 無從判斷

推薦人簽名：_____年 月 日

本表完成後，請簽名並上傳至線上平臺。